

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 9月 6日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2002-261870

[ST. 10/C]:

[JP2002-261870]

出 願 Applicant(s):

三菱化学株式会社

ス (文) (文) (文)

> 特許庁長官 Commissioner,

Japan Patent Office

2003年 8月14日





【書類名】 特許願

【整理番号】 J09226

【提出日】 平成14年 9月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C07C 67/34

C07C 27/02

C07C 31/20

C07C 69/16

C07D307/08

C07B 61/00 300

【発明の名称】 アリル化合物の製造方法及びアリル化合物

【請求項の数】 13

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学

株式会社内

【氏名】 田中 善幸

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学

株式会社内

【氏名】 高井 正樹

【特許出願人】

【識別番号】 000005968

【氏名又は名称】 三菱化学株式会社

【代理人】

【識別番号】 100092978

【弁理士】

【氏名又は名称】 真田 有

【電話番号】 0422-21-4222

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007696

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9802014

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 アリル化合物の製造方法及びアリル化合物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる群より選ばれる一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、下記一般式(I)で示される構造を有する単座配位ホスファイト化合物とを含む触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることによって新たなアリル化合物を製造する方法において、アンモニウム化合物を反応系に存在させることを特徴とするアリル化合物の製造方法。

P (O R^1) (O R^2) (O R^3) . . . 一般式(I) (上記一般式(I) において、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ独立に、置換基を有していても良いアルキル基を表わす。)

【請求項2】 周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる群より選ばれる一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、二座配位ホスファイト化合物とを含む触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることによって新たなアリル化合物を製造する方法において、アンモニウム化合物を反応系に存在させることを特徴とするアリル化合物の製造方法。

【請求項3】 該二座配位ホスファイト化合物が、下記一般式 (II) ~ (V) で表わされる構造を有することを特徴とする、請求項2記載のアリル化合物の製造方法。

【化1】

$$(R^{12}O)(R^{13}O)P - O - A^1 - O - P(OR^{14})(OR^{15})$$
 (III)

$$Z^{1}$$
 O P O A^{2} O $P(OR^{16})(OR^{17})$ (IV)

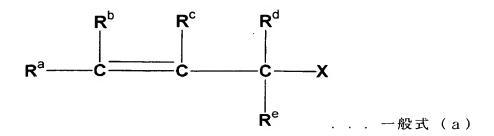
$$z^2$$
 O P O P O Z^3 (V)

(上記一般式(II)~(V)中、R 10 ~R 17 は、それぞれ独立に、置換基を有していても良いアルキル基又はアリール基(環の上下に芳香族 6 $^{\pi}$ 電子雲を形成する複素環式化合物を含む。以下同様。)を表わす。 21 ~ 23 及び 21 ~ 3 は、それぞれ独立に、二価の有機基を表す。 21 0、四価の有機基を表わす。)

【請求項4】 上記一般式(I)の R^1 、 R^2 及び R^3 のうち少なくとも一つが、分岐鎖状又は環状のアルキル基であることを特徴とする、請求項1記載のアリル化合物の製造方法。

【請求項5】 該アリル原料化合物が、下記一般式(a)で表される構造を有することを特徴とする、請求項1~4の何れか一項に記載のアリル化合物の製造方法。

【化2】



(上記一般式(a)において、Ra~Reは、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アミノ基、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、又はアシロキシ基を表す。これらの基は、更に置換基を有していても良く、炭素鎖を含む場合にはその炭素鎖中に一以上の炭素一炭素二重結合又は三重結合を有していても良い。Xは、ハロゲン原子、電子吸引性基が少なくとも一つ結合した炭素原子、ヒドロキシ基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、スルホネイト基、アシロキシ基、カーボネイト基、カルバメイト基、ホスフェイト基、アルコキシ基、アリーロキシ基を表わす。これらの基は、更に置換基を有していても良く、炭素鎖を含む場合にはその炭素鎖中に一以上の炭素一炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。また、Ra~Re及びXのうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。)

【請求項6】 該遷移金属化合物が、ルテニウム化合物、ロジウム化合物、 イリジウム化合物、ニッケル化合物、パラジウム化合物、及び白金化合物からな る群より選ばれる1種以上の化合物であることを特徴とする、請求項1~5の何 れか一項に記載のアリル化合物の製造方法。

【請求項7】 アンモニウム化合物が、下記一般式(1)で表される構造を有することを特徴とする、請求項 $1\sim6$ の何れか一項に記載のアリル化合物の製造方法。

N X 1 X 2 X 3 X 4 . . . 一般式 (1)

(上記一般式(1)中、 $X^1 \sim X^4$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子 、ヒドロキシ基、アミノ基、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリール アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基を表わす。これらの基は、更に置換基を有していても良く、炭素鎖を含む場合にはその炭素鎖中に一以上の炭素-炭素二重結合又は三重結合を有していても良い。また、 $X^1 \sim X^4$ のうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。)

【請求項8】 上記一般式(1)におけるX¹~X⁴のうち、1つが水素原子であり、残り3つがそれぞれ独立に、無置換又は置換のアルキル基又はアリール基である(これらのアルキル基又はアリール基のうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い)ことを特徴とする、請求項7記載のアリル化合物の製造方法。

【請求項9】 上記一般式(1)における $X^1 \sim X^4$ のうち全てが、それぞれ独立に、無置換又は置換のアルキル基又はアリール基である(これらのアルキル基又はアリール基のうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い)ことを特徴とする、請求項7記載のアリル化合物の製造方法。

【請求項10】 該アンモニウム化合物が、プロトンが配位結合した1,8 ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデセンー7、又は、プロトンが配位結合したトリアルキルアミンであることを特徴とする、請求項8記載のアリル化合物の製造方法。

【請求項11】 該二座配位ホスファイト化合物が、上記一般式(III)の 化合物であり、該アリル原料化合物が、下記一般式(b)で表される構造の化合物であり、該求核剤が、酢酸(CH_3COOH)若しくはその脱プロトン体(HO-)であり、 因は、水(H_2O)若しくはその脱プロトン体(HO-)であり、製造される該アリル化合物が、下記一般式(c)で表される構造の化合物であることを特徴とする、請求項 $7\sim10$ の何れか一項に記載のアリル化合物の製造方法。

$$CH_2 = CH - CHR^1 - CH_2R^2$$
 . . . 一般式 (b)

$$R^3CH_2-CH=CH-CH_2R^4$$
 . . . 一般式 (c)

(上記の一般式 (b) 及び一般式 (c) 中、 $R^{1} \sim R^{4}$ は、それぞれ独立に、アセ

トキシ基又はヒドロキシ基を表わす。)

【請求項12】 該二座配位ホスファイト化合物が、上記一般式(III)の化合物であり、該アリル原料化合物が、下記一般式(c)で表される構造の化合物であり、該求核剤が、酢酸(CH_3COOH)若しくはその脱プロトン体(CH_3COO)、又は、水(H_2O)若しくはその脱プロトン体(HO)であり、製造される該アリル化合物が、下記一般式(b)で表される構造の化合物であることを特徴とする、請求項 $7\sim10$ の何れか一項に記載のアリル化合物の製造方法。

$$CH_2 = CH - CHR^1 - CH_2R^2$$
 . . . 一般式 (b) $R^3CH_2 - CH = CH - CH_2R^4$. . . 一般式 (c)

(上記の一般式 (b) 及び一般式 (c) 中、 $R^{1} \sim R^{4}$ は、それぞれ独立に、アセトキシ基又はヒドロキシ基を表わす。)

【請求項13】 請求項1~12の何れか一項に記載の方法により得られたことを特徴とする、アリル化合物。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることにより、新たなアリル化合物を製造する方法、並びにそれにより製造されたアリル化合物に関する。

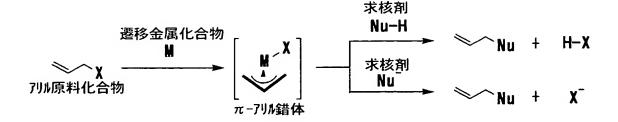
[0002]

【従来の技術】

アリル化合物を原料として、遷移金属化合物を用いた触媒反応を行なうことにより、様々な種類の新たなアリル化合物を合成することができる。その反応は、下の反応式に示すように、脱離基Xを有するアリル原料化合物が遷移金属化合物に π 配位及び酸化的付加することで、アリル部位の3つの炭素が金属に結合した π -アリル錯体が形成され、その π -アリル錯体の末端アリル炭素がN u - H又はN u - で表される求核剤により攻撃されることによって進行する。

[0003]

【化3】



[0004]

アリル化合物の合成反応の詳細に関しては、非特許文献1に総説的にまとめて 記載されているが、反応において求核剤の種類を選ぶことで、求核剤がアリル化 された形の様々な生成物を得ることができる。中でも、求核剤がアルコール類や フェノール類、カルボン酸類といった酸素求核剤の場合には、それぞれアリルア ルキルエーテルやアリルフェニルエーテル、カルボン酸アリルエステルが生成し 、合成化学的に有用な素反応の一つと言える。

[0005]

上述した触媒を用いたアリル化反応を工業的スケールで実施する場合には、貴金属である高価なパラジウムの使用量を減らす目的や反応器サイズを小さくして建設費コストを削減する目的等のために、反応性の向上が強く望まれる。そうした反応性を向上させる試みの一つとして、求核剤のカウンターカチオンを反応系中に存在させる方法が知られている。効果としては、そうしたカウンターカチオンとペアもしくは共存状態にある求核剤は、その求核攻撃力が増加しそれに伴って反応性が向上することである。

[0006]

具体的な例を幾つか示すと、非特許文献2において、シクロペンタジエンモノオキシドと酢酸アニオンの反応が報告されているが、この反応においては、反応性の向上のために酢酸アニオンのカウンターカチオンとしてナトリウムイオンが用いられている。しかしながら、こうしたアルカリ金属がカウンターカチオンの場合、+1価の電荷が小さな一つの金属イオン上に集中しているため、カウンターアニオンの求核剤と強いイオン対を形成する傾向にあるため、求核剤の攻撃力は十分に高いものとなっていない。

[0007]

また、アリルアルキル化反応の例として、様々なアリル原料化合物とマロン酸ジエステル誘導体類との反応が、数多くの学術論文で報告されているが、通常、マロン酸ジエステルの状態では反応性が低いため、水素化アルカリ金属等との反応により、カウンターカチオンとしてナトリウムイオン、リチウムイオン、カリウムイオンなどのアルカリ金属イオンを持つマロン酸ジエステルのカルボアニオンの状態で反応を行なわせている。これらの方法においては、上記の観点から活性が十分に高められているとは考えられない上、工業化プロセスへの適用を考えた場合、危険物第3類に該当する禁水性物質であり、水素ガスが発生するような水素化アルカリ金属等を大量に使用するのは望ましいとは言えない。

[0008]

上述したように、アリル化反応において反応性を促進させる目的で共存させる カウンターカチオンとして主にアルカリ金属カチオンが知られているが、ホスフ ァイト化合物からなる触媒系においてアンモニウムをカウンターカチオンとして 系中に共存させた反応例は限られた例しかない。非特許文献3には、トリアリー ル型の単座配位ホスファイトであるトリフェニルホスファイト配位子からなるパ ラジウム触媒を用い、プロトンが配位結合した1,8-ジアザビシクロ [5. 4 .0〕ウンデセン-7からなるアンモニウムの存在下にアリル原料化合物とマロ ン酸エステル類との反応を行っている例が記載されているが、反応は全く進行し ていない。また、非特許文献4には、トリアルキル型の単座配位ホスファイトで あるトリイソプロピルホスファイト配位子からなるパラジウム触媒を用い、プロ トンが配位結合したトリエチルアミンからなるアンモニウムの存在下にアリル原 料化合物と蟻酸アニオンとの反応を行なっている例が記載されているが、この反 応は通常のアリル原料化合物と求核剤との反応とは異なるタイプの反応である。 すなわち、蟻酸アニオンは中間体のπーアリル錯体を攻撃して蟻酸アリルエステ ルを生成させることはなく、パラジウムに配位した後、二酸化炭素が脱離し、そ の結果生じたヒドリドがπーアリル錯体と反応し、アリル原料化合物が還元され た構造の生成物を与えるだけであり、合成化学的観点から見ても重要性の高い反 応ではない。

8/

[0009]

【非特許文献1】

「Palladium Reagents and Catalysts -Innovations in Organic Synth esis-」 John Wiley & Sons社

【非特許文献2】

Organic Syntheses, 1988, 67, p114

【非特許文献3】

Organometallics, 2001, 20, p138

【非特許文献4】

Tetrahedron Lett., 1998, 39, p5439

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

上で述べてきたように、アリル原料化合物と求核剤との反応による種々のアリル化合物の製造を工業的スケールで実施するためには、触媒コストの削減が重要な項目の一つとなってくる。触媒コストの削減方法としては、反応性の向上による触媒使用量の低減、安価な配位子を利用することによる配位子コストの削減等を主に挙げることができるが、配位子として、合成が比較的難しいホスフィン系の配位子を使用した場合や、PーN、PーO、PーS、NーSといった複雑な二座配位子を用いた場合には、配位子の製造コストは高くなってしまう傾向にある。また、反応性の向上を目的とした新たな高活性型の触媒の創出には、膨大な開発コストや検討期間を有する場合がしばしばである。そのため、触媒系に変更を加えることなく、第3成分的な化合物の共存といった簡便な手法によって触媒活性を向上させる方法が提示されれば、有効な手法の一つとなり、非常に重要性が高いと言える。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、遷移金属化合物と特定構造の単座配位ホスファイト化合物又は任意の構造の 二座配位ホスファイト化合物とからなる触媒の下、アリル原料化合物と求核剤と を反応させて新たなアリル化合物を製造する方法において、触媒系に変更を加え

9/

ることなく、第3成分的な化合物の共存といった簡便な手法によって触媒の活性 を向上させ、効率的にアリル化合物を製造できるようにした、アリル化合物の製 造方法を提供することに存する。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、塩基の存在下、三塩化リンとフェノール類又はアルコール類との反応により比較的簡便に合成することができるホスファイト化合物を、周期表の第8~10族の遷移金属化合物との組み合わせによる触媒系の配位子として用い、様々なアリル化反応を鋭意検討していく中で、特定のホスファイト化合物を用いた場合に、求核剤のカウンターカチオンとしてアンモニウムを反応系中に存在させるといった簡便な手法によって反応性を数倍に高めることに成功し、本発明に到達した。本発明は、アンモニウムという緩いイオン対しか形成できないカウンターカチオンの存在によって、求核剤の求核攻撃性が高められたことが反応性向上の理由であると考えられるが、そうした理由から、πーアリル錯体に求核剤が攻撃することによって進行する、あらゆる種類のアリル化合物の製造方法に適用可能であると考えられる。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

すなわち、本発明の要旨は、周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる 群より選ばれる一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、下記一般式(I)で 示される構造を有するホスファイト化合物とを含む触媒の存在下、アリル原料化 合物と求核剤とを反応させることによって新たなアリル化合物を製造する方法に おいて、アンモニウム化合物を反応系に存在させることを特徴とするアリル化合 物の製造方法に存する。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

 $P(OR^1)(OR^2)(OR^3)$. . . 一般式(I)

(上記一般式(I)において、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ独立に、置換基を有していても良いアルキル基を表わす。)

[0015]

また、本発明の別の要旨は、周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる

群より選ばれる一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、二座配位ホスファイト化合物とを含む触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることによって新たなアリル化合物を製造する方法において、アンモニウム化合物を反応系に存在させることを特徴とするアリル化合物の製造方法に存する。

[0016]

更に、本発明の別の要旨は、上記のアリル化合物の製造方法により得られたことを特徴とするアリル化合物に存する。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

【発明の実施の形態】

以下、本発明につき詳細に説明する。

本発明に係るアリル化合物の製造方法(以下、適宜「本発明の製造方法」と略称する。)は、周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる群より選ばれる一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、特定構造の単座配位ホスファイト化合物又は任意の構造の二座配位ホスファイト化合物とを含む触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることによって新たなアリル化合物を製造するものであって、アンモニウム化合物を反応系に存在させることをその特徴としている。

[0018]

まず、本発明の製造方法の特徴となる、反応系に存在させるアンモニウム化合物について説明する。本発明に用いることのできるアンモニウム化合物は、基本的に窒素に4つの置換基が結合した構造であれば、特に限定されるものではない。そうした構造によって、従来からしばしば用いられているアルカリ金属イオンよりも緩いイオン対しか形成できないカウンターカチオンとなることから、それに伴って求核剤の攻撃性、すなわち反応性を高めることができる。その理由は、アルカリ金属イオンでは、小さなアルカリ金属イオンの表面に+1価の電荷が集中するのに対し、アンモニウム化合物では分子全体で+1価であり、電荷が集中している窒素原子は4つの置換基によって隠された構造となっていることが理由であると考えられる。

[0019]

通常、使用可能なアンモニウム化合物としては、反応条件下で安定であり、反応系中で溶解しており、且つ、触媒被毒しないもの(触媒被毒する化合物の例としては、共役ジエンを含む化合物や、ホスファイト化合物を酸化消失させるもの、例えばパーオキサイドを含む化合物等が挙げられる。)であれば特に限定されない。その分子量は、反応系での溶解性の観点から、通常3000以下、好ましくは2000以下、より好ましくは1000以下であり、通常20以上、好ましくは40以上、より好ましくは60以上である。

[0020]

中でも、下記一般式(1)で表される構造を有するアンモニウム化合物が好ましい。

[0021]

N X 1 X 2 X 3 X 4 . . . 一般式 (1)

[0022]

上記一般式(1)中、X¹~X⁴は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、若しくはアミノ基、又は、鎖状若しくは環状の、アルキル基、アリール基(なお、本明細書においてアリール基とは、環の上下に芳香族6π電子雲を形成する複素環式化合物を含むものとする。)、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、若しくはアリールチオ基を表わす。これらの例示基は、更に置換基を有していても良い。置換基としては、反応系に悪影響を及ぼす虞の無いものであれば特に制限されないが、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、若しくはアミノ基、又は、鎖状若しくは環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、若しくはアリールチオ基等が好ましい。これらの無置換又は置換の例示基が炭素鎖を含む場合には、その炭素鎖中に一以上の炭素一炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。

[0023]

なお、反応系に悪影響を及ぼす基としては、触媒を被毒させるもの、例えば共 役ジエンを含む基や、ホスファイト化合物を酸化消失させるもの、例えばパーオ キサイドを含む基などが挙げられる。従って、本明細書全体を通じて、「反応系に悪影響を及ぼす虞の無い」基とは、反応系に悪影響を及ぼすこれらの基を除くという意に解すべきである。

[0024]

 $X^{1} \sim X^{4}$ のうち任意の二以上の基が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。環の数は特に制限されないが、通常 $0 \sim 3$ 、好ましくは $0 \sim 2$ 、特に好ましくは0又は1である。また、個々の環を形成する原子の数も特に制限されないが、通常 $3 \sim 1$ 0員環、好ましくは $4 \sim 9$ 員環、特に好ましくは $5 \sim 7$ 員環である。複数の環が存在する場合、これらの環が一部を共有することによって縮合環構造を形成していても良い。

[0025]

 $X^1 \sim X^4$ の炭素数は、それぞれ独立に、通常 $0 \sim 40$ 、好ましくは $0 \sim 30$ 、より好ましくは $0 \sim 20$ である。 $X^1 \sim X^4$ のうち二以上の基が結合して環状構造を形成している場合、その炭素数は、環状構造の形成に関与している基の数を p とすると、通常 $0 \sim 40 \times p$ 、好ましくは $0 \sim 30 \times p$ 、特に好ましくは $0 \sim 20 \times p$ である。

$[0\ 0\ 2\ 6]$

上記例示の中でも、 $X^1 \sim X^4$ としては、それぞれ独立に、水素原子、又は、鎖状若しくは環状の、且つ、無置換若しくは置換の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、若しくはアルキルアリーロキシ基が好ましく、更には、鎖状又は環状の、且つ、無置換又は置換の、アルキル基又はアリール基がより好ましい。この場合も上述の様に、これらの $X^1 \sim X^4$ のアルキル基又はアリール基のうち任意の二以上が結合して一以上の環状構造を形成しても良い。

[0027]

補足すると、上記一般式(1)で示されるアンモニウム化合物の中には、Nー置換ピリジン、Nー置換オキサゾリウム、Nー置換チアゾリウム等のようなN=C二重結合を有する化合物も包含される。更に補足すると、置換基としてアミノ基を持つ場合のような二座キレート性のジアミン類も包含される。

[0028]

本発明に使用可能なアンモニウム化合物の具体的な例を示すと、トリメトキシアンモニウム、メトキシジメチルアンモニウム、クロロヒドロキシジシクロヘキシルアンモニウム、ブロモトリエチルアンモニウム、ジメチルチオジフェニルアンモニウム、トリ(t-ブチル)シクロヘキシルアンモニウム、エトキシトリス(t-メトキシフェニル)アンモニウム、メチルトリ(フェノキシ)アンモニウム、ジメトキシアセチルアンモニウム、トリ(エチルチオ)イソプロピルアンモニウム、ジエトキシエチルフェニルチオアンモニウム、テトラ(t-ブチル)アンモニウム、トリエチルヒドロアンモニウム、トリメチルー1ープロピニルアンモニウム、Nーt-ブチルー5ーメチルオキサゾリウム、t-メトキシピリジニウム、Nーフェニルチアゾリウム、Et2HNーCH2ーCH2ーNEt2、Me2HNーCH2ーCH2ーCH2ーNHMe2等、様々な例を挙げることができる。なお、本明細書において、Meはメチル基を、Etはエチル基をそれぞれ表わす。

[0029]

しかしながら、通常、容易に入手可能で本発明に好適に用いることができるものとしては、以下の2つのタイプのものを挙げることができる。

[0030]

①X¹~X⁴の内、1つが水素原子であり、残り3つがそれぞれ独立に、無置換又は置換のアルキル基又はアリール基からなるもの(これらのアルキル基又はアリール基のうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い)。

[0031]

②X¹~X⁴の内、全てがそれぞれ独立に、無置換又は置換のアルキル基又はアリール基からなるもの(これらのアルキル基又はアリール基のうち任意の二以上が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い)。

[0032]

タイプ①の具体的な例としては、トリエチルアンモニウム、トリイソプロピルアンモニウム、トリーnードデシルアンモニウム、ジエチルイソプロピルアンモ

ニウム、エチルーnープロピルーtーブチルアンモニウム、3ークロロー1ープロピルジフェニルアンモニウム、トリアリルアンモニウム、ゲラニルビス(4ーメトキシフェニル)アンモニウム、トリス(2, 4ージメチルフェニル)アンモニウム、3ーフルオロフェニルー2ーメチルフェニルー2ーナフチルアンモニウム、トリ(2ーナフチル)アンモニウム、ピリジニウム、4ーtーブチルアンモニウム、4-シアノピリジニウム、下記式(N-1)~(N-6)であらわされる化合物が挙げられる。

[0033]

【化4】

[0034]

タイプ②の具体的な例としては、テトラメチルアンモニウム、テトラベンジル

भूग क्रिस्ट 2 0 0 2

アンモニウム、テトラウンデセニルアンモニウム、トリメチルエチルアンモニウム、トリアリルー3-ペンチニルアンモニウム、トリエチルアリルアンモニウム、ジフェニルメチルエチルアンモニウム、トリメチルー2-ブテニルアンモニウム、ビス(4-メトキシー1-ブチル)ジエチルアンモニウム、ジ(1-ナフチル)ジイソプロピルアンモニウム、t-ブチルエチルイソプロピルー4-フルオロフェニルアンモニウム、トリス(4-エチルフェニル)-4-アセトキシー2-ブテニルアンモニウム、下記式(N-7)~(N-1 2)で表わされる構造の化合物等が挙げられる。

[0035]

【化5】

[0036]

(N-11)

上記のタイプ①及びタイプ②の化合物の中でも、水素以外の $X^1 \sim X^4$ が、無置換又は置換のアルキル基又はアリール基であるアンモニウム化合物が好ましい。この様なアンモニウム化合物の具体例としては、タイプ①では、トリーn-オクチルアンモニウム、トリス(6-t-ブチルー2-ナフチル)アンモニウム、ジーn-プロピルエチルメチルアンモニウム、n-プロピルーn-ブチルーn-ペンチルアンモニウム、2-クロロエチル-3-メトキシプロピル-4-トリメチ

(N-12)

ルシリルブチルアンモニウム等が挙げられ、タイプ②では、テトラーn-/ニルアンモニウム、テトラフェニルアンモニウム、ジエチルジイソプロピルアンモニウム、トリエチルベンジルアンモニウム、メチルエチル-n-プロピル-n-ブチルアンモニウム、メチルー t-ブチルジ(1-ナフチル)アンモニウム、5-ブロモペンチルジエチルメチルアンモニウム、トリス(2, 5-ジメチルフェニル)-n-オクチルアンモニウム等が挙げられる。

[0037]

上記のタイプ①及びタイプ②のうち、タイプ①で示されるアンモニウム化合物の方が、配位結合をしているプロトンを除いた元の第三級アミンと酢酸やフェノール等の酸性物質との酸塩基反応によって容易にアンモニウムに導くことができるため、経済的に好ましい。特に、プロトン以外の3つのアルキル基が全て同一であるタイプ①のアンモニウム化合物が、製造コストが安くなるため好ましい。この様なアンモニウム化合物の具体例としては、同一のアルキル基からなるトリアルキルアミンにプロトンが配位結合したアンモニウム、例えば、トリエチルアンモニウム、トリーnープロピルアンモニウム、トリイソプロピルアンモニウム、トリーnーブチルアンモニウム、トリーsecーブチルアンモニウム、トリーnーペンチルアンモニウム、トリーnーネオペンチルアンモニウム、トリイソオクチルアンモニウム、トリーnーオクチルアンモニウム、トリデカニルアンモニウム等が挙げられる。その他、1、8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデセンー7(DBU)にプロトンが配位結合したアンモニウム等も好ましい。

[0038]

上で述べてきたようなアンモニウム化合物を、アリル化反応を実施する反応系中に存在させると、反応性の向上といった効果が発現する。この場合、何れか一種のアンモニウム化合物を単独で用いて良いし、数種類のアンモニウム化合物を任意の組み合わせで混合して用いてもよい。

[0039]

アンモニウム化合物を反応系に存在させる方法は特に限定されるものではない 。しかしながら、例を示すとするならば、アンモニウム化合物を積極的に反応系 に添加する方法と、反応系中においてアンモニウム化合物を調製する方法が挙げ られる。これらの方法について、以下、更に具体例を示しながら説明する。

[0040]

まず、アンモニウム化合物を積極的に反応系に添加する方法については、アリ ル化合物や求核剤、触媒、反応媒体等と共にアンモニウム化合物を反応器内にフ ィードする方法で、このアンモニウム化合物は新しいアンモニウム化合物であっ ても、反応プロセスにおいてリサイクルされてきたアンモニウム化合物であって も構わない。注意すべき点として、通常、市販品として入手できるアンモニウム 化合物は、一つの窒素につき+1価の電荷に帯電しているため、それに対応する カウンターアニオンとの塩の形となっているが、反応系中においてはアンモニウ ムに対応するこのカウンターアニオンがアリル原料化合物と反応する求核剤であ ることが望ましい。仮に、カウンターアニオンが求核剤ではなく、別のカウンタ ーアニオンと塩の形になっているアンモニウム化合物を添加する場合には、別の カウンターアニオンが、触媒を被毒することなく、反応系中にアリル化合物との 反応等により自ずと消失し、新たに求核剤がカウンターアニオンとなることが望 まれる。通常の市販品のアンモニウム化合物のカウンターアニオンとしては、ク ロライド、ブロマイド、アイオダイドなどのハロゲン化物イオンのほか、ヘキサ フルオロホスフェイト、ヘキサクロロホスフェイト、ハイドロジェンサルフェイ ト、テトラクロロボレイト、トリフルオロメタンスルホネイト、パークロレイト 等が知られているが、これらの中で、一般的にハロゲン化物イオンが遷移金属触 媒を被毒する可能性が高いと考えられる。そのようなハロゲン化物アンモニウム 化合物を反応に用いる場合には、事前にアニオン交換反応等によって除去してお くとよい。この際、望ましくは新しいカウンターアニオンをアリル化反応で用い る求核剤にしておくと一層好ましい。

[0041]

一方、反応系中においてアンモニウム化合物を調製する方法については、アンモニウムの原料となるアミンやピリジン化合物等を添加する方法が挙げられる。これは、塩基性を示すこれらの化合物と、求核剤におけるプロトン酸性点とが反応器内で酸塩基反応を起こし、その結果、窒素上の非共有電子対にプロトンが配位結合した構造のアンモニウムやピリジニウム化合物が生成することに由来して

いる。このような方法を実施する際の注意点について述べると、この方法は、求核剤がプロトン酸性点を有している場合に良好に実施することができ、フェノールやカルボン酸類といった酸素求核剤及びマロン酸エステル誘導体類といった炭素求核剤との反応において特に効果を発揮するが、求核剤がアミン類といった窒素求核剤の場合にはアミン類がそもそも塩基性であるため大きな効果を発現しない点である。また、その他の注意事項として、アンモニウムの原料として加えるアミン化合物の遷移金属化合物に対する配位力があまりに高い場合には、元々遷移金属化合物に配位していた配位子を脱離させてしまい、触媒活性が低下してしまう場合があり得る。そのような場合には、やはり事前に系外でアンモニウム化合物の形に変換してフィードするか、プロセスの運転中に徐々にアンモニウム化合物の形に変換してフィードするか、プロセスの運転中に徐々にアンモニウム化合物に変化していくことを待つことなどが対策として挙げられる。

[0042]

上記のアンモニウム化合物の使用量は、経済性を考えると少ないほど有利であるが、後述の実施例でも示される様に、アンモニウム化合物の存在量が多くなると触媒活性の向上は徐々に緩やかになるので、後で詳しく述べるアリル化反応触媒である金属化合物に対する比率(モル比)として、通常 0.1以上、好ましくは1以上、より好ましくは5以上、更に好ましくは10以上、最も好ましくは15以上であり、通常 1000以下、好ましくは500以下、より好ましくは1000以下、更に好ましくは500以下である。

[0043]

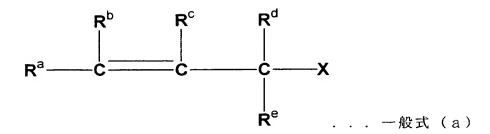
続いて、本発明の製造方法のその他の要件について説明する。

[0044]

まず、本発明の製造方法に使用されるアリル原料化合物について説明する。アリル原料化合物の種類は特に制限されないが、Ra~Reで表される基を有するアリル基に、Xで表される脱離基が結合した、下の一般式(a)で表わされる構造の化合物が好ましい。なお、脱離基とは、母体となる基質骨格(本発明ではアリル骨格)の炭素に結合していて、一般的に電子吸引性基で、電子対を持って基質分子から離れていく原子又は原子団のことを指す。

[0045]

【化6】



[0046]

上記一般式(a)において、Ra~Reは、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、鎖状又は環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アミノ基、アミド基、アシル基、又はアシロキシ基を表わす。これらの例示基は更に、置換基を有していても良い。置換基としては、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、鎖状又は環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アミノ基、アミド基、アシル基、又はアシロキシ基等が好ましい。

[0047]

 $R^{a} \sim R^{e}$ の炭素数は、通常 $0 \sim 40$ 、好ましくは $0 \sim 30$ 、更に好ましくは $0 \sim 20$ である。なお、 $R^{a} \sim R^{e}$ が炭素鎖を含む基である場合には、その炭素鎖中に一以上の炭素 – 炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。

上記例示の中でも、Ra~Reとしては、それぞれ独立に、水素原子、無置換又は置換のアルキル基、無置換又は置換のアリール基が好ましい。

[0048]

一方、脱離基Xは、ヒドロキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ROC(=O) 一で表される電子吸引性基が少なくとも一つ結合した炭素原子、RC(=O)O ーで表されるアシロキシ基、ROC(=O)Oーで表されるカーボネイト基、R NHC(=O)Oーで表されるカルバメイト基、(RO) $_2$ P(=O)Oーで表 されるホスフェイト基、R $_2$ Nーで表されるアミノ基、RSO $_2$ ーで表されるスル ホニル基、RSO₂O-で表されるスルホネイト基、RO-で表されるアルコキシ基又はアリーロキシ基等を表わす。なお、前記各式中におけるRは、水素原子又は有機基を表わす。有機基としては、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば、その種類は特に制限されないが、アルキル基、アリール基等が好ましい。Rが有機基である場合の炭素数は、通常1~40、好ましくは1~30、更に好ましくは1~20である。なお、脱離基Xが炭素鎖を含む基である場合には、その炭素鎖中に一以上の炭素-炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い

[0049]

上記例示のうち、Xとしては、アシロキシ基、ヒドロキシ基、カーボネイト基が好ましい。アシロキシ基の具体例としては、アセトキシ基、メチルアセトキシ基、エチルアセトキシ基等が挙げられる。カーボネイト基の具体例としては、メチルカーボネイト基、エチルカーボネイト基、フェニルカーボネイト基等が挙げられる。特にXとしては、アセトキシ基又はヒドロキシ基が好ましい。

[0050]

なお、上述のRa~Re及びXのうち任意の二以上の基が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。但し、Xが安定した環状構造に含まれると、Xが脱離し難くなるので好ましくない。環の数は特に制限されないが、通常0~3、好ましくは0~2、特に好ましくは0又は1である。また、個々の環を形成する原子の数も特に制限されないが、通常3~10員環、好ましくは4~9員環、特に好ましくは5~7員環である。複数の環が存在する場合、これらの環が一部を共有することによって縮合環構造を形成していても良い。

[0051]

 $R^{a}\sim R^{e}$ 及びXのうち二以上の基が結合して環状構造を形成している場合、その炭素数は、環状構造の形成に関与している基の数をpとすると、通常 $0\sim40$ × p、好ましくは $0\sim30\times p$ 、特に好ましくは $0\sim20\times p$ である。

[0052]

上記一般式(a)のアリル原料化合物の例としては、カルボン酸のアリルエステル類、アリルカーボネイト類、アリルカルバメイト類、リン酸アリルエステル

類、アリルアミン類、アリルスルホン類、アリルスルホネイト類、アリルエーテ ル類、アリルアルコール類、ハロゲン化アリル類、ビニルエチレンオキシド類、 1-ビニルー2.2ージアルキルカルボキシレイトシクロプロパン類等が挙げら れる。カルボン酸のアリルエステル類の具体例としては、酢酸アリル、酢酸-2 - ヘキセニル、酢酸プレニル、酢酸-3-ブテン-2-イル、酢酸-2-シクロ ペンテニル、プロピオン酸ー1ーフェニルー1ーブテンー3ーイル、酪酸-1-シクロヘキシルー2-ブテン、1,4-ジアセトキシブテンー2、3-アセトキ シー4-ヒドロキシブテン-1等が挙げられる。アリルカーボネイト類の具体例 としては、アリルメチル炭酸エステル、4-アセトキシー2-ブテニルエチル炭 酸エステル、ネリルメチル炭酸エステル等が挙げられる。アリルカルバメイト類 の具体例としては、アリルーNー(4ーフルオロフェニル)カルバメイト、2ー ブテニル-N-メチルカルバメイト、フルフリル-N-(2 -メトキジフェニル)カルバメイト等が挙げられる。リン酸アリルエステル類の具体例としては、リ ン酸アリルジメチルエステル、リン酸-3-メチル-2-ブテニルジフェニルエ ステル、リン酸メチルエチルフルフリルエステル等が挙げられる。アリルアミン 類の具体例としては、アリルジエチルアミン、3-メトキシアリルジフェニルア ミン、トリアリルアミン、2-ブテニルジベンジルアミン等が挙げられる。アリ ルスルホン類の具体例としては、アリルフェニルスルホン、メチリルーpートリ ルスルホン、2-メチル-3-スルホレン、1,3-ジフェニルアリルメチルス ルホン等が挙げられる。アリルスルホネイト類の具体例としては、アリルトルエ ンー4-スルホネイト、3-チオフェンメタンスルホネイト、4-クロロー2-ブテニルメタンスルホネイト等が挙げられる。アリルエーテル類の具体例として は、アリルエチルエーテル、アリルフェニルエーテル、2,3-ジフェニルアリ ルイソプロピルエーテル、2-ブテニル-4-フルオロフェニルエーテル等が挙 げられる。アリルアルコール類の具体例としては、2-ブテニルアルコール、2 ,3-ジメチル-2-ブテニルアルコール、3-ブロモアリルアルコール等が挙 げられる。ハロゲン化アリル類の具体例としては、1-ニトロー2-ブテン、1 ーニトロー1,3-ジフェニルプロペン、3-ニトロー3-メトキシプロペン等 に代表されるようなニトロアリル類、塩化アリル、臭化-2-ブテニル、1-ク

ロロー2ーフェニルー2ーペンテン等が挙げられる。ビニルエチレンオキシド類の具体例としては、ブタジエンモノオキシド、シクロペンタジエンモノオキシド、1, 3-シクロヘキサジエンモノオキシド等が挙げられる。1-ビニルー2, 2-ジアルキルカルボキシレイトシクロプロパン類の具体例としては、<math>1-ビニルー2, 2-ジメチルカルボキシレイトシクロプロパン、ビシクロ[3.1.0] <math>-6, 6-ジエチルカルボキシレイト-2-ヘキセン等が挙げられる。

[0053]

これらのアリル原料化合物の中でも、全体の分子量として1500以下のもの (炭素数で約100以下のもの) であり、反応条件下において全量又は一部のア リル原料化合物が、溶媒への溶解、求核剤との相溶、若しくは熱による融解等に よって、溶けた状態になり得るものが好ましい。具体的には、Ra〜Reがそれぞ れ独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基であって、Xが、アセトキシ 基及びヒドロキシ基から選ばれる基であるものが挙げられる。特に、Xがアセト キシ基である化合物の具体例として、酢酸アリル、酢酸-2-ヘキセニル、酢酸 ゲラニル、酢酸ファルネシル、酢酸-2,4-ヘキサジエニル、酢酸-2-トリ メチルシリルメチルー2ープロペニル、酢酸-2ーメチル-2ーシクロヘキセニ ル、酢酸シンナミル、酢酸リナリル、酢酸-3-ブテン-2-イル、4-シクロ・ ペンテンー1、3-ジオールー1-アセテイト等が挙げられる。また、脱離基が ヒドロキシ基である化合物の具体例として、アリルアルコール、シンナミルアル コール、クロチルアルコール、3-メチル-2-シクロヘキセン-1-オール、 3-メチル-2-ブテン-1-オール、ゲラニオール、2-ペンテン-1-オー ル、3-ブテン-2-オール、1-ヘキセン-3-オール、2-メチル-3-フ ェニルー2ープロペンー1ーオール、1ーアセトキシー4ーヒドロキシシクロペ ンテンー2、1,2ージヒドロカテコール、3ーヘキセンー2,5ージオール等 が挙げられる。

[0054]

なお、特に好ましいアリル原料化合物として、下記一般式(b)で表される3 ,4-二置換ブテン-1、下記一般式(c)で表される1,4-二置換ブテン-2、及びそれらの化合物からなる群より選ばれる二以上の化合物の混合物を挙げ ることができる。

[0055]

 $CH_2 = CH - CHR^1 - CH_2R^2$. . . 一般式 (b)

[0056]

上記一般式 (b) 中、 R^1 , R^2 は、それぞれ独立に、アセトキシ基又はヒドロキシ基を表わす。上記一般式 (b) で表わされる 3, 4 — 二置換ブテン — 1 の具体例としては、 3, 4 — ジアセトキシブテン — 1、 3 — アセトキシー 4 — ヒドロキシブテン — 1、 4 — アセトキシー 3 — ヒドロキシブテン — 1、 4 — アセトキシー 4 — ジヒドロキシブテン — 1 が挙げられる。

[0057]

 $R^3CH_2-CH=CH-CH_2R^4$. . . 一般式 (c)

[0058]

上記一般式 (c) 中、 R^3 、 R^4 は、それぞれ独立に、アセトキシ基又はヒドロキシ基を表わす。上記一般式 (c) で表わされる 1 、4 一二置換ブテンー 2 の具体例としては、 1 、4 ージアセトキシブテンー 2 、 1 ーアセトキシー 4 ーヒドロキシブテンー 2 、 1 、 4 ージヒドロキシブテンー 2 が挙げられる。

[0059]

次に、本発明の製造方法に使用される求核剤について説明する。

一般的に求核剤とは、非共有電子対を持ち、塩基性で、炭素核を攻撃する傾向を有している反応体のことを指すが、本発明ではその種類に特に制限は無く、基本的にあらゆる種類の求核剤を用いることができる。しかし、πーアリル錯体に求核攻撃してアリル化合物を生成させるという目的から、本発明で使用する求核剤としては、それぞれ酸素原子、炭素原子、及び窒素原子上の非共有電子対が求核攻撃を行なう酸素求核剤、炭素求核剤、及び窒素求核剤が好ましい。なお、反応速度を向上させるためには、反応条件下において全量又は一部の求核剤が、溶媒への溶解、アリル原料化合物との相溶、若しくは熱による融解等によって、溶けた状態になり得るものが好ましい。この様な観点で、通常は分子量600以下の求核剤を用いる。

[0060]

本発明で使用可能な酸素求核剤は、具体的には、求核性の酸素原子を含む E^1 O-Hで表わされるプロトン付加体の化合物、又は、その脱プロトン体である E^1 O-で表わされるアニオン、更には、反応系の中でそのアニオンとなり得る化合物である。前記式中、 E^1 は、水素原子又は有機基を表わす。有機基としては、炭素原子、窒素原子、リン原子、又は硫黄原子により当該求核性の酸素原子と結合するものであって、反応系で液体となり、且つ、反応系に悪影響を及ぼす虞が無いものが用いられる。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

 E^1 が有機基の場合、その炭素数は、通常は $1\sim30$ の範囲が、反応系で溶解し易いので好ましい。中でも好ましくは $1\sim20$ 、特に好ましくは $1\sim10$ である。また、酸素求核剤の分子量は通常400以下、好ましくは300以下、特に好ましくは200以下である。

[0062]

求核性酸素と炭素原子で結合する有機基としては、無置換又は置換の鎖状アルキル基、無置換又は置換の環状アルキル基、無置換又は置換のアリール基等が挙げられる。求核性酸素と窒素原子で結合する有機基としては、無置換又は置換のアミノ基、C=N結合を有する基等が挙げられる。求核性酸素とリン原子で結合する有機基としては、無置換又は置換のホスホネイト基、ホスフィネイト基、ホスフィノイル基等が挙げられる。求核性酸素と硫黄原子で結合する有機基としては、無置換又は置換のスルホニル基等が挙げられる。なお、上記各例示基の置換基としては、有機基であって、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、鎖状又は環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、又はアシロキシ基等が好ましい。上記各例示基がこれらの置換基を有する場合には、置換基も含めた炭素数が上記範囲内となるようにする。

[0063]

酸素求核剤の具体例をプロトン付加体の形態で列挙すると、 E^1 が水素原子の場合は、水である。

E¹が求核性酸素と炭素原子で結合した有機基である場合には、アルコール類 、アリロール類、脂肪族カルボン酸類、芳香族カルボン酸類、チオカルボン酸類 、セレノカルボン酸類等が挙げられる。アルコール類の具体例としては、メタノ ール、エタノール、nープロパノール、nーブタノール、secーブタノール、 t ーブタノール、アリルアルコール、2 ーエチルヘキシルアルコール、4 ークロ ロー1ーブタノール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、エチレングリ コール、1.3ープロパンジオール、1.4ーブタンジオール等が挙げられる。 アリロール類の具体例としては、フェノール、p-メトキシフェノール、2, 4 ージメチルフェノール、1ーナフトール、2ーナフトール、3,6ージーtーブ チルー2ーナフトール、2ーピリジノール、2, ーブロモー4ーピリジノール等 が挙げられる。脂肪族カルボン酸類の具体例としては、酢酸、プロピオン酸、酪 酸、クロロ酢酸、シュウ酸、アジピン酸等が挙げられる。芳香族カルボン酸類の 具体例としては、安息香酸、ナフタレンー2ーカルボン酸、mーシアノ安息香酸 、o-トルイル酸等が挙げられる。チオカルボン酸類の具体例としては、CHვ C(=S) - OHで表わされる化合物、PhC(=S) - OHで表わされる化合 物等が挙げられる。セレノカルボン酸類の具体例としては、CH╕(C=Se) - O H で表わされる化合物、 P h C (= S e) - O H で表わされる化合物等が挙 げられる。なお、本明細書において、Phはフェニル基を表わす。

[0064]

 E^1 が求核性酸素と窒素原子で結合した有機基である場合には、オキシム類、ヒドロキシアミン類等が挙げられる。オキシム類としては、アセトンオキシム、ベンゾフェノンオキシム、シクロペンタノンオキシム等が挙げられる。ヒドロキシアミン類としては、N, Nージエチルヒドロキシアミン、N, Nージベンジルヒドロキシアミン等が挙げられる。その他該当する有機基としては、tーブチルーNーヒドロキシカーバメイト、Nーヒドロキシマレイミド、Nーヒドロキシスクシンイミド、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール等が挙げられる。

[0065]

E¹が求核性酸素とリン原子で結合した有機基である場合には、ホスフィン酸 類、ホスホン酸エステル類、リン酸エステル類等が挙げられる。ホスフィン酸類 としては、ジメチルホスフィン酸、ジフェニルホスフィン酸等が挙げられる。ホスホン酸エステル類としては、エチルホスホン酸、プロピルホスホン酸モノフェニルエステル等が挙げられる。リン酸エステル類としては、リン酸ジフェニルエステル、リン酸ジメチルエステル等が挙げられる。

[0066]

 E^1 が求核性酸素と硫黄原子で結合した有機基である場合には、p-1ルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸等のスルホン酸類、硫酸モノフェニルエステル、硫酸モノオクチルエステル等の硫酸モノエステル類が挙げられる。

[0067]

なお、上述の例示は全てプロトン付加体で示したが、各例示化合物の脱プロトン体、また、反応系の中で当該脱プロトン体となり得る化合物も同様に例示される。反応系の中で当該脱プロトン体となり得る化合物としては、当該脱プロトン体体がその他の原子又は原子団と結合した化合物が挙げられる。当該脱プロトン体と結合するその他の原子又は原子団としては、各種の一価のカチオン(Na+, K+等)などが挙げられる。

[0068]

以上例示の中でも、E¹が求核性酸素と炭素原子で結合した有機基である場合が特に好ましく、具体的には、以下のタイプ①~④の酸素求核剤が特に好ましい

[0069]

①RO-H又はRO-(前記式中、Rは、置換基を有していてもよく、炭素鎖中 に二重結合や三重結合を有していても良いアルキル基を表わす。)で表されるア ルコール類又はそれらの脱プロトン体。

[0070]

②ArO-H又はArO-(前記式中、Arは、置換基を有していてもよく、窒素、酸素、リン、硫黄のような他の元素を含んでいても良いアリール基を表わす。)で表されるヒドロキシアリール類又はそれらの脱プロトン体。

[0071]

③R'COO-H又はR'COO-(前記式中、R'は、水素原子又はアルキル 基を表し、更に置換基を有していても良く、炭素鎖中に二重結合や三重結合を有 していても良い基を表わす。)で表される脂肪族カルボン酸類又はそれらの脱プ ロトン体。

[0072]

④Ar'COO-H又はAr'COO-(前記式中、Ar'は、置換基を有していてもよく、窒素、酸素、リン、硫黄のような他の元素を含んでいても良いアリール基を表わす。)で表される芳香族カルボン酸類又はそれらの脱プロトン体。

[0073]

タイプ①の酸素求核剤としては、飽和又は不飽和のアルコール及びそれらの置換基含有体、飽和又は不飽和のジオールや多置換アルコール又はそれらの置換基含有体等が挙げられる。飽和又は不飽和のアルコール及びそれらの置換基含有体の具体例としては、メチルアルコール、エチルアルコール、ロープロピルアルコール、iープロピルアルコール、ローブチルアルコール、2ーエチルへキサノール、ローオクタノール、アリルアルコール、クロチルアルコール、ベンジルアルコール、1ーブロモー2ープロパノール、2ーメチルシクロペンタノール、2ーフェニルエタノール、ネオペンチルアルコール、4ーシクロへキセノール、コレステロール等が挙げられる。飽和又は不飽和のジオールや多置換アルコール又はそれらの置換基含有体の具体例としては、1,2ーエタンジオール、1,3ープロパンジオール、1,4ーブタンジオール、2ーブテンー1,4ージオール、2ークロロー1,3ープロパンジオール、1,2ーシクロペンタンジオール、グリセリン、ペンタエリトリトール等が挙げられる。

[0074]

これらの中でも、タイプ①の酸素求核剤としては、飽和のアルコール又は飽和のジオールが好ましく、具体的には、メチルアルコール、エチルアルコール、 n ープロピルアルコール、 i ープロピルアルコール、 n ーブチルアルコール、 2 ーエチルヘキサノール、 n ーオクタノール、 1, 2 ーエタンジオール、 1, 3 ープロパンジオール、 1, 4 ーブタンジオール等が好ましい。

[0075]

タイプ②の酸素求核剤としては、モノヒドロキシアリール及びそれらの置換基含有体、ジ又は多ヒドロキシアリール及びそれらの置換基含有体等が挙げられる。モノヒドロキシアリール及びそれらの置換基含有体の具体例としては、フェノール、クレゾール、4ーニトロフェノール、2ーフルオロフェノール、2,4ージーtーブチルフェノール、2,4ージーtーブチルフェノール、3ーtーブチルー6ーメチルフェノール、1ーナフトール、2ーナフトール、3ーtーブチルー2ーナフトール等が挙げられる。ジ又は多ヒドロキシアリール及びそれらの置換基含有体の具体例としては、カテコール、レソルシノール、ヒドロキノン、2,4ージヒドロキシフェニルエチルケトン、4ーnーへキシルレソルシノール、1,8ージヒドロキシナフタレン、1,2ージヒドロキシナフタレン、1,2ージヒドロキシナフタレン、1,2ージヒドロキシナフタレン、1,2,4ーベンゼントリオール等が挙げられる。

[0076]

これらの中でも、タイプ②の酸素求核剤としては、モノヒドロキシアリール又はジヒドロキシアリールが好ましく、具体的には、フェノール、1ーナフトール、2ーナフトール、カテコール、レソルシノール、ヒドロキノン、2,6ージヒドロキシナフタレン等が好ましい。

[0077]

タイプ③の酸素求核剤としては、飽和脂肪族カルボン酸及びそれらの置換基含有体、不飽和脂肪族カルボン酸及びそれらの置換基含有体、脂肪族ジカルボン酸及びそれらの置換基含有体としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸、ラウリン酸、シクロヘキサンカルボン酸、αーメチル酪酸、γークロローαーメチル吉草酸、αーヒドロキシプロピオン酸、γーフェニル酪酸等が挙げられる。不飽和脂肪族カルボン酸及びそれらの置換基含有体としては、アクリル酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、2ーシクロヘキセンカルボン酸、4ーメトキシー2ーブテン酸、メタクリル酸等の不飽和脂肪族カルボン酸及びそれらの置換基含有体等が挙げられる。脂肪族ジカルボン酸及びそれらの置換基含有体としては、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、マレイン酸、フマル酸等が挙げられる。

[0078]

これらの中でも、タイプ③の酸素求核剤としては、飽和脂肪族カルボン酸又は 飽和脂肪族ジカルボン酸が好ましく、具体的には、酢酸、プロピオン酸、酪酸、 吉草酸、カプロン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルチミン酸、ステアリン酸 、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸等が好ましい。

[0079]

タイプ④の酸素求核剤としては、芳香族カルボン酸及びそれらの置換基含有体 、芳香族ジ又は多カルボン酸及びそれらの置換基含有体が挙げられる。芳香族カ ルボン酸及びそれらの置換基含有体としては、安息香酸、3-シアノ安息香酸、 2-ブロモ安息香酸、2,3-ジメトキシ安息香酸、4-フェノキシ安息香酸、 pーニトロ安息香酸、mートルイル酸、 o ーメトキシ安息香酸、フタル酸モノメ チルエステル、テレフタル酸モノエチルエステル、ナフタレン-1-カルボン酸 、1-メチルナフタレン-2-カルボン酸、2-エトキシナフタレン-1-カル ボン酸、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、1-ブロモナフタレン-2-カルボン酸、アントラセン-9-カルボン酸、フェナントレン-4-カルボ ン酸、ピコリン酸、ニコチン酸、イソニコチン酸、2-メトキシチオニコチン酸 、6-クロロニコチン酸、イソキノリン-1-カルボン酸、キノリン-3-カル ボン酸、キノリンー4ーカルボン酸、4-メトキシキノリン-2-カルボン酸等 が挙げられる。芳香族ジ又は多カルボン酸及びそれらの置換基含有体としては、 フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ベンゼン-1,2,4-トリカルボン 酸、ベンゼン-1,2,4,5-テトラカルボン酸、ナフタレン-1,4-ジカ ルボン酸、ナフタレンー1、8-ジカルボン酸、ナフタレンー2、3-ジカルボ ン酸、ナフタレンー2,6-ジカルボン酸、ナフタレンー1,4,5,8-テト ラカルボン酸等が挙げられる。

[0080]

これらの中でも、タイプ④の酸素求核剤としては、芳香族カルボン酸又はジカルボン酸が好ましく、具体的には、安息香酸、ナフタレン-2,6-ジカルボン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等が好ましい。

[0081]

炭素求核剤としては、 $E^2E^3E^4C^-$ で表されるカルボアニオン類、又は E^2E^3 E^4C Hで表わされるそのプロトン付加体が、好ましい例として挙げられる。前記式において、 $E^2\sim E^4$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ基、ニトロ基、スルホニル基、カルボキシ基、又は、鎖状若しくは環状の、アルキル基、アリール基、アシル基、カルバモイル基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アリーロキシ基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキリデンアミノ基、若しくはジアルコキシホスホリル基を表わす。上記各例示基は更に置換基を有していても良い。置換基としては、有機基であって、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、鎖状又は環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルアリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、又はアシロキシ基等が好ましい。

[0082]

なお、 $E^2 \sim E^4$ として上に例示した置換基及びそれらの付属的な置換基が炭素鎖を含む基である場合には、その炭素鎖中に一以上の炭素 - 炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。また、 $E^2 \sim E^4$ のうち任意の二以上の基が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。更に、 $E^2 \sim E^4$ のうち少なくとも一つは、電子吸引基である必要がある。中でも $E^2 \sim E^4$ のうち二つ以上が電子吸引基であることが好ましい。

[0083]

炭素求核剤の炭素数は、通常 $1\sim50$ 、好ましくは $1\sim40$ 、特に好ましくは $1\sim30$ である。また、その分子量は通常600以下、好ましくは500以下、特に好ましくは400以下である。

[0084]

上述の炭素求核剤のうち、カルボアニオン類は、非共有電子対にプロトン等の 置換基が結合した電荷を帯びていない化合物から生成されるが、そうした元の化 合物のまま反応に用いてもよいし、プロトン等を引き抜いてカルボアニオンの状 態にしてから反応に用いてもよい。後者の場合、一般的に、カルボアニオンのカ ウンターカチオンとしてアルカリ金属イオンを用いると、より高い反応活性で反応を行なうことができる。通常、炭素求核剤は、元の化合物からプロトンが引き抜かれて初めて、求核性を示すカルボアニオンという構造を取るので、元の化合物は活性プロトン、即ち酸性のプロトンを有する化合物 (プロトン付加体) であることが望ましい。

[0085]

炭素求核剤として好ましいものとしては、マロン酸エステル誘導体、α-置換 酢酸エステル誘導体、置換ニトロメタン誘導体、ジアシルメタン誘導体、スルホ ニルメタン誘導体、置換アセトニトリル、アルキリデンアミノメタン誘導体等が 挙げられる。それぞれの具体例を水素付加体の形式で列挙すると、マロン酸エス テル誘導体の具体例としては、マロン酸ジエチル、メチルマロン酸ジエチル等が 挙げられ、αー置換酢酸エステル誘導体の具体例としては、αーブロモプロピオ ン酸エチル、アセト酢酸エチル、シアノ酢酸メチル、イソシアノ酢酸ベンジル、 フェニルスルホニル酢酸エチル、ニトロ酢酸ブチル、フェニルチオイソシアノ酢 酸-t-ブチル等が挙げられ、置換ニトロメタン誘導体の具体例としては、ニト ロエタン、ジニトロメタン等が挙げられ、ジアシルメタン誘導体の具体例として は、ヘプタンー3,5-ジオン、ペンタンー2,4-ジオン等が挙げられ、スル ホニルメタン誘導体の具体例としては、ジメチルスルホニルメタン、フェニルス ルホニルアリル等が挙げられ、置換アセトニトリルの具体例としては、フェニル アセトニトリル、フェノキシフェニルチオアセトニトリル等が挙げられ、アルキ リデンアミノメタン誘導体の具体例としては、シクロヘキシリデンアミノメチル ホスホン酸ジエチル、ビス(2-プロピリデンアミノ)メタン等が挙げられ、そ の他としては、フルオレン等が挙げられる。

[0086]

炭素求核剤としてより好ましいのは、 $E^2 \sim E^4$ のうち少なくとも一つがアルコキシカルボニル基である化合物である。こうした化合物の具体例としては、マロン酸ジエチル、アセト酢酸エチル、シアノ酢酸メチルが挙げられる。中でも、 $E^2 \sim E^4$ のうち二つがアルコキシカルボニル基である化合物が特に好ましい。こうした化合物の具体例としては、マロン酸ジエチルが挙げられる。

[0087]

窒素求核剤としては、HNE5E6で表わされる、少なくとも一つの水素原子と結合したアミン類が、好ましい例として挙げられる。前記式において、E5又は E6はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ基、ニトロ基、スルホニル基、カルボキシ基、又は、鎖状若しくは環状の、アルキル基、アリール基、アシル基、カルバモイル基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アリーロキシ基を表わす。上記各例示基は更に置換基を有していても良い。置換基としては、有機基であって、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、鎖状又は環状の、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールアルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、又はアシロキシ基等が好ましい。

[0088]

なお、 E^5 及び E^6 として上に例示した置換基及びそれらの付属的な置換基が炭素鎖を含む基である場合には、その炭素鎖中に一以上の炭素 - 炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。また、 E^5 及び E^6 が互いに結合して、一以上の環状構造を形成していても良い。

[0089]

窒素求核剤の炭素数は、通常 $1\sim40$ 、好ましくは $1\sim30$ 、特に好ましくは $1\sim20$ である。また、その分子量は通常500以下、好ましくは400以下、特に好ましくは300以下である。

[0090]

アミン類との反応の場合、アミンの窒素上の非共有電子対が π -アリル錯体の末端アリル炭素に求核攻撃することによって、中間体としてアンモニウムカチオン状態となるが、そこからプロトンが抜けて電荷的に中性のアリルアミン類が生成するために、水素原子が少なくとも一つ結合したアミン類である必要がある。しかしながら、アミン類の求核性を一層高める目的で、事前にプロトンを化学処理等により引き抜いて、 E^5E^6N —のようなアニオン化されたアミン類の形で反応に使用してもよい。その場合、アニオン化されたアミン類のカウンターカチオ

ンとして、アルカリ金属イオン等を挙げることができる。

[0091]

窒素求核剤として好ましいものとしては、アンモニア、第一級アミン、第二級 アミン、N-無置換又は一置換アミド化合物類、複素環式環状アミン類、ジアミ ン又は多アミン類等が挙げられる。それぞれの具体例を水素付加体の形式で列挙 すると、第一級アミンの具体例としては、エチルアミン、n-ブチルアミン、i ープロピルアミン、アリルアミン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミン、フ ェニルアミン、フェノキシアミン等が挙げられ、第二級アミンの具体例としては 、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーiープロピルアミン、ジフェニルアミ ン、ジ(2-ブテニル)アミン、t-ブチル-n-ブチルアミン、メチルフェニ ルアミン、N-クロロ-N-フェニルアミン、N-エトキシ-N-エチルアミン 、N-n-オクチル-N-ヒドロキシアミン、ジフェノキシアミン等が挙げられ 、N-無置換又は一置換アミド化合物類の具体例としては、カプロアミド、3-ブロモベンズアミド、エトキシカルボニルアミン、N-ブロモアセトアミド、4 ーフルオロアセトアニリド、シクロヘキシルジーi-プロピルアミノカルボニル アミン、メトキシカルボニルプロピルアミン、カルボキシルグリシン、フェノキ シカルボニルフェニルアミン等が挙げられ、複素環式環状アミン類の具体例とし ては、ピロール、イミダゾール、ピロリジン、インドール、2,5ージメチルピ ロリジン、モルホリン、4-クロロー2,5-ジヒドロキノリン等が挙げられ、 ジアミン又は多アミン類の具体例としては、テトラメチレンジアミン、N, N' ージエチルエチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、1.3.5ートリアミ ノベンゼン等が挙げられる。

[0092]

窒素求核剤としてより好ましいのは、 E^5 及び E^6 の少なくとも一方が無置換又は置換のアルキル基である第一級アミン、第二級アミンである。こうした化合物の具体例としては、ジメチルアミン、ジーi-プロピルアミン、ジーn-ウンデシルアミン、2-エトキシエチルーt-ブチルアミン、ビス(4-ブロモシクロヘキシル)アミン、N-3,5-ジメチルヘキシルーN-2-エチルヘキシルアミン、x-ブチルアミン、x-ブチルアミン、x-ブチルアミン、x-ブチルアミン

、3-クロローn-プロピルアミン、シクロヘキシルアミン、ジーn-ペンチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、メチルエチルアミン、4-シアノーn-デシルネオペンチルアミンが挙げられる。中でも、 E^5 及び E^6 がともに無置換又は置換のアルキル基である第二級アミン類が特に好ましい。こうした化合物の具体例としては、ジメチルアミン、ジーi-プロピルアミン、ジーn-ウンデシルアミン、2-エトキシエチルーt-ブチルアミン、ビス(4-プロモシクロヘキシルアミン、N-3、5-ジメチルヘキシル-N-2-エチルヘキシルアミンが挙げられる。

[0093]

続いて、本発明の製造方法で使用される触媒について説明する。本発明で使用される触媒は、一以上の遷移金属化合物と、特定構造の単座配位ホスファイト化合物、又は、二座配位ホスファイト化合物とを含む。

[0094]

遷移金属化合物としては、周期表の第8~10族(IUPAC無機化学命名法改訂版(1998)による)に属する遷移金属からなる群より選ばれる、一以上の遷移金属を含む化合物が使用される。具体的には、鉄化合物、ルテニウム化合物、オスミウム化合物、コバルト化合物、ロジウム化合物、イリジウム化合物、ニッケル化合物、パラジウム化合物及び白金化合物等が挙げられるが、中でもルテニウム化合物、ロジウム化合物、イリジウム化合物、ニッケル化合物、パラジウム化合物及び白金化合物が好ましく、更にはニッケル化合物、パラジウム化合物及び白金化合物が好ましく、東にはニッケル化合物、パラジウム化合物及び白金化合物が好ましく、特にパラジウム化合物が好ましい。これらの化合物の種類は任意であるが、具体例としては、上記遷移金属の酢酸塩、アセチルセトネイト化合物、ハライド、硫酸塩、硝酸塩、有機塩、無機塩、アルケン配位化合物、アミン配位化合物、ピリジン配位化合物、一酸化炭素配位化合物、ホスフィン配位化合物、ホスファイト配位化合物等が挙げられる。

[0095]

遷移金属化合物の具体例を列記すると、鉄化合物としては、 $Fe(OAc)_2$ 、 $Fe(acac)_3$ 、 $FeCl_2$ 、 $Fe(NO_3)_3$ 等が挙げられる。ルテニウム化合物としては、 $RuCl_3$ 、 $Ru(OAc)_3$ 、 $Ru(acac)_3$ 、 $RuCl_2$

(PPh₃)₃等が挙げられる。オスミウム化合物としては、OsCl₃、Os(OAc) 3等が挙げられる。コバルト化合物としては、Co(OAc) 2、Co(acac)₂、CoBr₂、Co(NO₃)₂等が挙げられる。ロジウム化合物とし ては、RhCl3、Rh (OAc) 3、 [Rh (OAc) 2] 2、Rh (acac) (CO) 2、 [Rh (OAc) (cod)] 2、 [RhCl (cod)] 2等が挙 げられる。イリジウム化合物としては、IrCl3、Ir(OAc)3、[IrC l (cod)] 2が挙げられる。ニッケル化合物としては、NiCl2、NiBr 2、Ni (NO3) 2、NiSO4、Ni (cod) 2、NiCl2 (PPh3) 3等が 挙げられる。パラジウム化合物としては、Pd(0)、PdCl₂、PdBr₂、 $PdCl_2$ (cod), $PdCl_2$ (PPh_3) 2, Pd (PPh_3) 4, Pd_2 (d ba) 3, K₂PdCl₄, K₂PdCl₆, PdCl₂ (PhCN) 2, PdCl₂ (CH₃CN) ₂, Pd (dba) ₂, Pd (NO₃) ₂, Pd (OAc) ₂, Pd (C F₃COO)₂、PdSO₄、Pd (acac)₂、その他、カルボキシレート化合 物、オレフィン含有化合物、Pd(PPh3)4等のような有機ホスフィン含有化 合物、アリルパラジウムクロライド二量体等が挙げられる。白金化合物としては 、Pt (acac) 2、PtCl2 (cod)、PtCl2 (CH3CN) 2、Pt Cl₂ (PhCN)₂, Pt (PPh₃)₄, K₂PtCl₄, Na₂PtCl₆, H₂ P t C 1 6が挙げられる。なお、以上の例示において、 c o d は 1 , 5 ーシクロ オクタジエンを、dbaはジベンジリデンアセトンを、acacはアセチルアセ トネイトを、Acはアセチル基をそれぞれ表す。

[0096]

遷移金属化合物の種類は特に制限されず、活性な金属錯体種であれば、単量体 、二量体、及び/又は多量体の何れであっても構わない。

[0097]

遷移金属化合物の使用量については特に制限はないが、触媒活性と経済性の観点から、反応原料であるアリル化合物に対して、通常 1×10^{-8} (0.01モル p p m) モル当量以上、中でも 1×10^{-7} (0.1モル p p m) モル当量以上、特に 1×10^{-6} (1モル p p m) モル当量以上、また、通常1モル当量以下、中でも0.001モル当量以下、特に0.001モル等量以下の範囲で使用する

のが好ましい。

[0098]

続いて、本発明に用いられるホスファイト化合物について述べる。本発明に使用できるホスファイト化合物は、特定の構造を有する単座配位ホスファイト化合物と、任意の構造の二座配位ホスファイト化合物とに大きく分けることができる。何れの場合も、触媒活性を上げるためには、反応系で溶解しているものが良く、その分子量は、単座配位ホスファイト化合物の場合、通常1500以下、好ましくは1200以下、より好ましくは900以下であり、通常100以上、好ましくは130以上、より好ましくは160以上である。二座配位ホスファイト化合物の場合、通常3000以下、好ましくは2000以下、より好ましくは1500以下であり、通常250以上、好ましくは300以上、より好ましくは400以上である。

[0099]

本発明に用いられる単座配位ホスファイト化合物は、下記一般式 (I) で示される構造を有する単座配位ホスファイト化合物である。

[0100]

上記一般式(I)において、R¹、R²、R³は、それぞれ独立に、鎖状又は環状のアルキル基を表わす。このアルキル基は、更に置換基を有していても良く、炭素鎖を含む場合にはその炭素鎖中に一以上の炭素一炭素二重結合又は三重結合が存在していても良い。置換基としては、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、具体的には、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ホルミル基、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリーロキシ基、アミノ基、アミド基、パーフルオロアルキル基、トリアルキルシリル基、エステル基等が好ましい。

[0101]

 R^1 、 R^2 、 R^3 の炭素数は、通常 $1\sim 40$ 、好ましくは $1\sim 30$ 、更に好ましくは $1\sim 20$ である。アルキル基が置換基を有する場合には、その置換基も含めた炭素数が上記範囲内になるものとする。

[0102]

[0103]

上記例示基の中でも、 R^1 、 R^2 、 R^3 としては、分岐鎖状又は環状のアルキル基が好ましい。その具体例としては、 $i-\mathcal{P}$ ロピル基、 $t-\mathcal{P}$ チル基、ネオペンチル基、 $2-\mathcal{P}$ チル本、シクロプロピル基、イソノニル基、イソデシル基、4, $4-\mathcal{P}$ チルー $1-\mathcal{P}$ ルー $1-\mathcal{P}$ ル 基、シクロ $1-\mathcal{P}$ ル 基等が挙げられる。特に、 R^1 、 R^2 、 R^3 としては、第二級アルキル基又は第三級アルキル基がとりわけ好ましい。その具体例としては、 $i-\mathcal{P}$ ロピル基、 $t-\mathcal{P}$ チルプロピル基、 $1-\mathcal{P}$ ル 基、シクロプロピル基、 $1-\mathcal{P}$ ル 基、シクロプチル基、シクロプチル基、シクロプチル基等が挙げられる。

[0104]

上記一般式(I)の単座配位ホスファイト化合物の具体例としては、トリメチ

ルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリプロピルホスファイト、トリー $i-\mathcal{P}$ ロピルホスファイト、トリアリルホスファイト、トリー $n-\mathcal{P}$ アリルホスファイト、トリー $n-\mathcal{P}$ ルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、エチルジー $t-\mathcal{P}$ ルホスファイト、 2-x チルペキシルジエチルホスファイト、 2-x チルホスファイト、 2-x チルホスファイト、 2-x チルホスファイト、 2-x チルホスファイト、 2-x トリス (2-x アーピル) ホスファイト、 2-x トリス (2-x アーピル) ホスファイト、 2-x トリス (2-x アートリス (2-x アートリス (2-x アーピル) ホスファイト、 2-x アーピル) ホスファイト、 2-x アール 2-x アート 2-x アール 2-x アール

[0105]

【化7】

$$\begin{array}{c|c} H_2 & C \\ \hline C & P - O \\ \hline H_2 & C \\ \hline H_2 & C \\ \hline H_3 & C \\ \hline \end{array}$$

(M-7)

$$H_{2}C$$
 $H_{2}C$
 H

$$H_{2}$$
 H_{2}
 H_{2}
 H_{2}
 H_{2}
 $(M-10)$

[0106]

中でも、 R^1 、 R^2 、 R^3 のうち少なくとも一つが、分岐鎖状又は環状のアルキル基である単座配位ホスファイト化合物が好ましい。その具体例としては、t ーブチルジアリルホスファイト、イソオクチルジベンジルホスファイト、ビス(3ークロロプロピル)ネオペンチルホスファイト、シクロプロピルジ(2 ーブテニル)ホスファイト、ジエチルーi ープロピルホスファイト、ジメチルーt ーブチルホスファイト、シクロヘキシルジメチルホスファイト、トリネオペンチルホスファイト、ジイソオクチルネオペンチルホスファイト、ジシクロヘキシルイソブチルホスファイト等が挙げられる。

[0107]

特に、 R^1 、 R^2 、 R^3 がそれぞれ独立に、第二級アルキル基又は第三級アルキル基である単座配位ホスファイト化合物が好ましい。その具体例としては、トリーi-プロピルホスファイト、ジーi-プロピルーt-ブチルホスファイト、トリシクロヘキシルホスファイト、トリシクロヘプチルホスファイト、ジシクロヘキシルーt-ブチルホスファイト、i-プロピルーt-ブチルホスファイト、i-プロピルーt-ブチルー1, 1-ジメチルプロピルホスファイト等が挙げられる。それらの中でも、トリーi-プロピルホスファイトが最も好ましい。

[0108]

一方、二座配位ホスファイト化合物としては、反応条件下で安定であり、反応 系中で遷移金属にリン原子で配位するもので、且つ、触媒被毒しないもの(触媒 被毒する化合物の例は前述の通りである。)であれば特に限定されないが、下記 一般式(II)~(V)で表される化合物が好ましい。

$[0\ 1\ 0\ 9]$

【化8】

$$(R^{12}O)(R^{13}O)P \longrightarrow O \longrightarrow A^1 \longrightarrow O \longrightarrow P(OR^{14})(OR^{15})$$
 (III)

$$Z^{1}$$
 O P O A^{2} O $P(OR^{16})(OR^{17})$ (IV)

$$z^2$$
 O P O P O Z^3 (V)

[0110]

上記一般式(II)~(V)において、 $R^{10} \sim R^{17}$ は、それぞれ独立に、それぞれ独立に、鎖状若しくは環状のアルキル基、又はアリール基を表わす。アルキル基の例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、i-プテル基、s e c-ブチル基、t-プチル基、n-プチル基、デシル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基等が挙げられる。アリール基の例としては、フェニル基、トリル基、キシリル基、ジーt-ブチルフェニル基、ナフチル基、ジーt-ブチルフェニル基、ナフチル基、ジーt-ブチルナフチル基、ピリジル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、インドリル基、フラニル基、チオフェニル基、オキサゾリル基、チアゾリル基等が挙げられる。

$[0\ 1\ 1\ 1]$

なお、上述のアルキル基及びアリール基は、更に置換基を有していても良い。 この置換基としては、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、具体的には、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ホ ルミル基、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリーロキシ基、アミノ基 、アミド基、パーフルオロアルキル基、トリアルキルシリル基、エステル基等が 好ましい。

[0112]

 $R^{31} \sim R^{37}$ の炭素数は、通常 $1 \sim 40$ 、好ましくは $1 \sim 30$ 、更に好ましくは $1 \sim 20$ である。上述のアルキル基又はアリール基が更に置換基を有している場合には、この置換基を含めた全体の炭素数が上記範囲となるようにする。

[0113]

上記例示基のうち、上述のホスファイトの安定性を考えると、 $R^{31} \sim R^{37}$ とし ては、無置換又は置換のアリール基が好ましい。無置換又は置換のアリール基の 具体例としては、フェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、 4-メチルフェニル基、2.3-ジメチルフェニル基、2.4-ジメチルフェニ ル基、2、5ージメチルフェニル基、2、6ージメチルフェニル基、2ーエチル フェニル基、2-イソプロピルフェニル基、2-t-ブチルフェニル基、2.4 ージー t ーブチルフェニル基、2 ークロロフェニル基、3 ークロロフェニル基、 4-クロロフェニル基、2、3-ジクロロフェニル基、2、4-ジクロロフェニ ル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,5-ジ クロロフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、2-メトキシフェニル 基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフ ェニル基、4-シアノフェニル基、4-ニトロフェニル基、ペンタフルオロフェ ニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、2ーメチルー1ーナフチル基、3ー t-ブチル-2-ナフチル基、3-メチロキシカルボニル-2-ナフチル基、3 .6-i-t-iチルー2ーナフチル基、5,6,7,8ーテトラヒドロナフタ レンー2ーイル基、5,6,7,8ーテトラヒドロナフタレンー1ーイル基等が 挙げられる。

[0114]

Z¹~Z³及びA¹~A³は、それぞれ独立に、二価の有機基を表わす。その種類としては、反応系に悪影響を及ぼす虞のないものであれば特に制限されないが、 無置換又は置換の、アルキレン基、アリーレン基、アルキレンーアリーレン基、 又はジアリーレン基が好ましい。 $Z^{1}\sim Z^{3}$ 及び $A^{1}\sim A^{3}$ の各々の炭素数は、通常 $1\sim 6$ 0 である。中でも、無置換又は置換のアルキレン基、無置換又は置換のアリーレン基、無置換又は置換のアルキレンーアリーレン基の場合には、その炭素数は通常 40 以下、好ましくは 30 以下、更に好ましくは 20 以下である。一方、無置換又は置換のジアリーレン基の場合には、その炭素数は通常 60 以下、好ましくは 10 以下である。

[0115]

アルキレン基は、鎖状であっても環状であっても良い。アルキレン基が有していても良い置換基の好ましい例としては、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ホルミル基、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリーロキシ基、アミノ基、アミド基、パーフルオロアルキル基、トリアルキルシリル基、エステル基等が挙げられる。無置換又は置換のアルキレン基の具体例としては、エチレン基、テトラメチルエチレン基、1,3-プロピレン基、2,2-ジメチルー1,3-プロピレン基、1,4-ブチレン基等が挙げられる。

[0116]

アリーレン基が有していても良い置換基の好ましい例としては、上述のアルキレン基が有していても良い置換基の好ましい例と同一の基が挙げられる。無置換又は置換のアリーレン基の具体例としては、1,2-フェニレン基、1,3-フェニレン基、3,5-ジーtーブチルー1,2-フェニレン基、2,3-ナフチレン基、1,4-ジーtーブチルー2,3-ナフチレン基、1,8-ナフチレン基等が挙げられる。

$[0\ 1\ 1\ 7]$

アルキレンーアリーレン基が有していても良い置換基の好ましい例としては、 上述のアルキレン基が有していても良い置換基の好ましい例と同一の基が挙げられる。無置換又は置換のアルキレンーアリーレン基の具体例としては、下記式(D-1) ~ (D-12) で表わされる構造の置換基が挙げられる。

[0118]

[化9]

[0119]

[0120]

【化10】

[0121]

【化11】

[0122]

【化12】

[0123]

【化13】

[0124]

以上述べてきたように、一般式(II)~(V)で示される二座配位ホスファイト化合物を構成する置換基の組合せにより、様々な構造の二座配位ホスファイトを用いることができるが、その中でも好ましい具体例として、下記の(L-1)~(L-56)等のような二座配位ホスファイトを挙げることができる。

[0125]

【化14】

$$H_3C$$
 CH_3
 H_2
 H_2
 H_3
 H_3C
 CH_3
 H_2
 H_3
 H_4
 H_2
 H_3
 H_3
 C
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 H_2 H_2 H_3C H_3C H_3C H_3C H_4 H_2 H_2 H_3 H_4 H_5 H_5

[0.1.26]

【化15】

$$H_3C$$
 CH_3 H_3C CH_3 CH_3

$$\begin{pmatrix}
H_{2}C & C & CH_{2} \\
H_{3}C & CH_{3}
\end{pmatrix}_{2}$$

$$\begin{pmatrix}
H_{2}C & CH_{2} & CH_{3} \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{pmatrix}_{2}$$

$$(L-6)$$

$$\begin{pmatrix}
H_{3}C & CH & CH_{3} \\
CH & CH & CH_{3} \\
P & Q & P \\
H_{2} & Q & P
\end{pmatrix}$$
(L-7)

[0127]

【化16】

$$\begin{pmatrix}
\mathsf{H}_{3}\mathsf{C} & \mathsf{CH}_{2} \\
\mathsf{CH}_{3} & 2
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
\mathsf{H}_{2}\mathsf{C} & \mathsf{CH}_{2} \\
\mathsf{CH}_{3} & 2
\end{pmatrix}$$

$$(L-9)$$

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{H_{3}C} & \mathbf{CH_{3}} & \mathbf{H_{2}C} - \mathbf{CH_{2}} \\
\mathbf{H_{3}C} & \mathbf{CH_{3}} & \mathbf{H_{3}C} - \mathbf{CH_{3}} \\
2 & \mathbf{CH_{3}} & \mathbf{CH_{3}}
\end{pmatrix}$$
(L-12)

[0128]

【化17】

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{H_3C} & \mathbf{CH_2} \\
\mathbf{CH_3} & \mathbf{CH_3}
\end{pmatrix}_{2}$$

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{L}-13)
\end{pmatrix}_{2}$$

$$\begin{pmatrix}
H_3C & CH_3 \\
CH & O & P & CH_2 \\
CH_3 & CH & CH_3
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
CH_2 & CH_3 \\
CH & CH_3
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
CH_2 \\
H_2 \\
P
\end{pmatrix}$$
P
$$(L-15)$$

[0129]



【化18】

[0130]



【化19】

$$\begin{pmatrix} H_3C & CH_2 & H_2C & CH_3 \\ H_2C & CH & C & CH_3 \\ H_2 & H_2 & H_2 & H_2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_2C & CH_3 \\ H_2 & C & CH_3 \\ H_2 & H_2 & H_2 & H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L-21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{H_{3}C} \\ \mathbf{H_{3}C} \\ \mathbf{H_{3}C} \\ \mathbf{CH_{2}} \end{pmatrix}_{2} \begin{pmatrix} \mathbf{CH_{3}} \\ \mathbf{CH_{3}} \\ \mathbf{CH_{3}} \\ \mathbf{CH_{3}} \end{pmatrix}_{2}$$
 (L-22)

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 CH_3

[0131]



$$\begin{pmatrix} \mathbf{H_{3}C} & \mathbf{CH_{3}} \\ \mathbf{CH_{3}} \end{pmatrix}_{2} \begin{pmatrix} \mathbf{CH_{3}} \\ \mathbf{CH_{3}} \end{pmatrix}_{2}$$
 (L-28)

[0132]

【化21】

$$\begin{array}{c|c} & \text{H}_{3}\text{C} & \text{CH}_{3} \\ \end{array}$$

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{C} & \mathbf{H_3} \\
\mathbf{C} & \mathbf{H_3} \\
\mathbf{C} & \mathbf{H_3} \\
\mathbf{C} & \mathbf{C} \\
\mathbf{C} \\
\mathbf{C} & \mathbf{C}$$

[0133]

【化22】

$$H_{2}C$$
 CH_{2}
 $H_{2}C$
 CH_{2}
 $H_{2}C$
 CH_{3}
 $H_{2}C$
 CH_{3}
 $H_{2}C$
 CH_{3}
 $CH_{2}C$
 CH_{3}
 $CH_{2}C$
 $CH_{2}C$
 CH_{3}
 $CH_{2}C$
 $CH_{3}C$
 $CH_{2}C$
 $CH_{3}C$
 $CH_{2}C$
 $CH_{3}C$
 $CH_{2}C$
 $CH_{3}C$
 $CH_{3}C$
 $CH_{2}C$
 $CH_{3}C$
 CH_{3}

[0134]

【化23】

$$H_3C$$
 CH
 CH_3
 CH
 CH_3
 CH
 CH_3
 CH
 CH_3

[0135]



$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_3C
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_3
 $(L-41)$

$$H_3C$$
 CH_3 CH_3

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ \end{array}$$

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_2
 H_3

[0136]



[0137]



$$CH_2$$
 H_2
 H_2
 H_2
 $(L-49)$

$$H_3C$$
 H_3C
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2

[0138]

【化27】

[0139]

上で例示してきた上記一般式(I)~(V)で表される構造の二座配位ホスファイトの中でも、上記一般式(III)~(V)の二座配位ホスファイトが好ましく、その具体例として、上記式(L -6)~(L -56)の化合物が好ましい。更に、二座配位ホスファイトの安定性を向上させるためにも、R 10 ~R 17 がそれぞれ独立に、無置換又は置換のアリール基であり、 Z^{1} ~ Z^{3} 及び A^{1} ~ A^{3} がそれぞれ独立に、無置換又は置換のジアリーレン基であることが好ましく、その具体例として、上記式(L -24)~(L -30)、(L -45)、(L -46)、(L -52)~(L -56)の化合物が好ましい。それらの中でも最も好ましくは、上記一般式(III)の二座配位ホスファイトであり、その具体例として、上記式(L -24)~(L -30)の化合物が挙げられる。

[0140]

Ĺ

上述の単座配位又は二座配位のホスファイト化合物の使用量は、上記遷移金属 化合物に対する比率(モル比)として、通常0.1以上、好ましくは0.5以上 、特に好ましくは1.0以上、また、通常1000以下、好ましくは500以 下、特に好ましくは100以下の範囲である。

[0141]

上記の遷移金属化合物とホスファイト化合物とは、それぞれ単独に反応系に添加してもよいし、或いは予め錯化した状態で使用してもよい。又は、上記ホスファイト化合物を何らかの不溶性樹脂担体等に結合させたものに、上記遷移金属化合物を担持させた、不溶性固体触媒の状態として反応に用いても良い。更に、1種類のホスファイト化合物のみを使用して反応を行なっても、2種類以上のホスファイト化合物を任意の組み合わせで同時に用いて反応を行なっても良い。2種類以上を使用する場合には、単座配位ホスファイト化合物及び二座配位のホスファイト化合物の何れか一方のみから2種以上を選択しても良く、単座配位ホスファイト化合物及び二座配位のホスファイト化合物及び二座配位のホスファイト化合物の双方からそれぞれ1種若しくは2種以上を選択してそれらを組み合わせて用いても良い。

$[0 \ 1 \ 4 \ 2]$

以上説明した遷移金属化合物及び単座配位又は二座配位ホスファイト化合物からなる触媒を用いて、上述のアンモニウム化合物の存在下、アリル原料化合物と

求核剤とを反応させることにより、新たなアリル化合物を効率よく製造することができる。

[0 1 4 3]

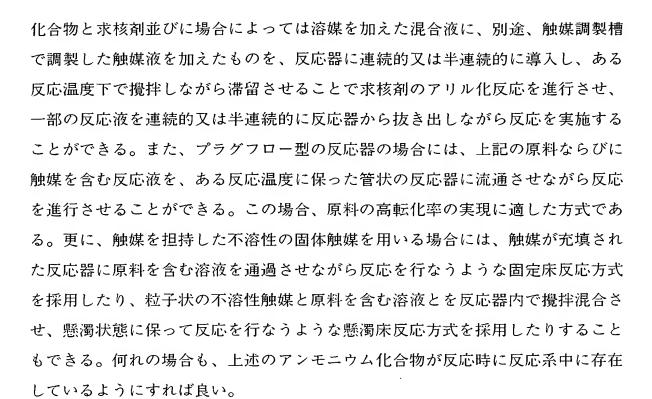
本発明の製造方法を実施するに当たって、通常は液相中で反応を行なう。反応 は溶媒の存在下或いは非存在下の何れでも実施し得る。溶媒を使用する場合、上 述のアンモニウム化合物と触媒及び原料化合物とを溶解するものであって、触媒 活性に悪影響を及ぼさないものであれば、任意の溶媒を使用可能であり、その種 類には特に限定はない。好ましい溶媒の具体例を列挙すると、酢酸、プロピオン 酸、酪酸等のカルボン酸類、メタノール、n-ブタノール、2-エチルヘキサノ ール等のアルコール類、ジグライム、ジフェニルエーテル、ジベンジルエーテル 、ジアリルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン等のエーテル 類、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ ド等のアミド類、シクロヘキサノン等のケトン類、酢酸ブチル、γーブチロラク トン、ジ(n-オクチル)フタレイト等のエステル類、トルエン、キシレン、ド デシルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン等の脂肪族炭化水素類、アリル化反応系内で副生物として生成する高沸物、原 料であるアリル化合物、生成物であるアリル化合物、原料アリル化合物の脱離基 に由来する化合物等が挙げられる。これらの溶媒の使用量は特に限定されるもの ではないが、原料であるアリル化合物の合計量に対して、通常0.1重量倍以上 、好ましくは0.2重量倍以上、また、通常20重量倍以下、好ましくは10重 量倍以下である。

[0144]

実際に反応を行なうに当たっては、様々な反応方式を用いることができる。例 えば、攪拌型の完全混合反応器、プラグフロー型の反応器、固定床型の反応器、 懸濁床型の反応器等を用いて、連続方式、半連続方式又は回分方式のいずれでも 行なうことができる。

[0145]

それぞれについて実際に反応を行なう時には、反応基質や生成物により適宜条件を検討すれば良いが、例えば攪拌型の完全混合反応器の場合には、アリル原料



[0146]

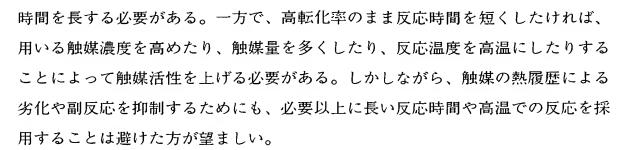
反応温度は、触媒反応が進行する温度であれば特に限定されないが、パラジウム等の貴金属化合物を触媒として使用する場合は、高温になり過ぎるとメタル化が起こり有効な触媒濃度が低減する危険性がある。また、高温ではホスファイト化合物の分解も懸念されることから、通常0 \mathbb{C} 以上、好ましくは2 0 \mathbb{C} 以上、更に好ましくは5 0 \mathbb{C} 以上、また、通常1 8 0 \mathbb{C} 以下、好ましくは1 6 0 \mathbb{C} 以下、更に好ましくは1 5 0 \mathbb{C} 以下が推奨される。

$[0\ 1\ 4\ 7]$

反応器内の雰囲気としては、溶媒、原料化合物、反応生成物、反応副生物、触媒分解物等に由来する蒸気以外は、アルゴンや窒素等の反応系に不活性なガスで満たされていることが望ましい。特に注意を払うべき点として、空気の漏れ込み等による酸素の混入は、触媒の劣化、特にホスファイト化合物の酸化消失の原因となることから、その量を極力低減させることが望ましい。

[0148]

反応器内の溶液の滞留時間、すなわち反応時間は、目指すべき原料の転化率の 値によって左右されるが、一定の触媒濃度の下では、高転化率を求めるほど反応



[0149]

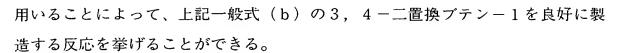
また、反応により得られたアリル化合物と触媒の分離には、慣用の液体触媒再循環プロセスで用いられるあらゆる分離操作を採用することができる。分離操作の具体例としては、単蒸留、減圧蒸留、薄膜蒸留、水蒸気蒸留等の蒸留操作のほか、気液分離、蒸発(エバポレーション)、ガスストリッピング、ガス吸収及び抽出等の分離操作が挙げられる。各成分の分離操作を各々独立の工程で行なってもよく、2以上の成分の分離を単一の工程で同時に行なってもよい。一部のアリル原料化合物や求核剤が未反応で残っている場合には、同様の分離方法で回収し、再び反応器にリサイクルするとより経済的である。更に分離された触媒もそのまま反応器にリサイクル若しくは回収して再活性化後再利用する方が経済的で望ましい。

[0150]

本発明では、触媒及びアンモニウム化合物の存在下、上で示してきた様々なア リル原料化合物と求核剤とを反応させることにより、数多くのアリル化合物を製 造することが可能であるが、中でも好適な反応例について以下に記載する。

[0151]

好ましい反応例としては、アリル原料化合物として上記一般式(b)で表される構造の化合物(3,4-二置換ブテン-1)を用い、且つ、求核剤として酢酸(CH_3COOH)若しくはその脱プロトン体(CH_3COOH)、又は、水(H_2O)若しくはその脱プロトン体(HOH)を用いることによって、上記一般式(c)で表される構造の化合物(1,4-二置換ブテン-2)を良好に製造する反応、及び、アリル原料化合物として上記一般式(c)の1,4-二置換ブテン-2を用い、且つ、求核剤として酢酸(CH_3COOH)若しくはその脱プロトン体(CH_3COOH)、又は、水(H_2O)若しくはその脱プロトン体(HOH)を



[0152]

中でも特に好ましい反応例は、アリル原料化合物として3, 4-ジアセトキシブテン-1を用い、且つ、求核剤として酢酸(CH_3COOH)又はその脱プロトン体(CH_3COO -)を用いた1, 4-ジアセトキシブテン-2の製造、及び、アリル原料化合物として1, 4-ジアセトキシブテン-2を用い、且つ、求核剤として酢酸(CH_3COOH)又はその脱プロトン体(CH_3COO -)を用いた3, 4-ジアセトキシブテン-1の製造である。

[0153]

[0154]

上記の好ましい反応を実施するのに特に適した触媒は、パラジウム化合物及び上記一般式(III)~(V)で示される二座配位ホスファイト化合物の組み合わせからなる触媒で、特に上記一般式(III)で示される二座配位ホスファイト化合物との組合せが触媒安定性の点からも好ましい。その触媒系に更に本発明の上記式(1)で表されるアンモニウム化合物が存在することによって反応性が数倍に高められる。更に、上記異性化反応においては、酢酸が共存することによって反応が促進される。そのため、反応溶媒として酢酸を採用することが好ましい実施形態と言える。酢酸の存在量は、触媒活性、触媒の安定性及び経済性の観点から、酢酸/アリル原料化合物の重量比で、通常1/1000以上、好ましくは1/10以上、更に好ましくは1/10以上、また、通常5/1以下、好ましく

は4/1以下、更に好ましくは2/1以下の範囲内である。

[0155]

本発明は、ブタジエンを、酢酸及び酸素の存在下に触媒によってジアセトキシ 化反応させて得られた目的物の1,4ージアセトキシブテンー2と副生成物の3,4ージアセトキシブテンー1を含む反応生成物から、3,4ージアセトキシー1ーブテンを主成分とする反応液を分離して、続いて本発明の方法により異性化 することで1,4ージアセトキシブテンー2を得るプロセスに採用する場合に特に有効である。かかる異性化反応によって収率が高められた1,4ージアセトキシブテンー2は、その後、水添反応、加水分解反応を経て、ポリエステルやポリウレタン原料となる1,4ーブタンジオールや、溶剤又はPTMG(ポリテトラメチレンエーテルグリコール)ポリマー用の原料となるテトラヒドロフランを製造するための重要な中間体である。

[0156]

【実施例】

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例に制約されるものではない。

[0157]

<実施例1~4及び比較例1~3>

パラジウムー二座配位ホスファイト(L-26)触媒の存在下、アリル原料化合物として3,4ージアセトキシブテンー1(以下34DABEと略す)を用い、求核剤として酢酸アニオンを用いたアリル化反応(異性化反応)を行なうことで1,4ージアセトキシブテンー2(以下14DABEと略す)を製造する反応に本発明を適用した。

[0158]

遷移金属化合物としてパラジウム含有量 21.5 重量%のトリスジベンジリデンアセトンジパラジウム 0.087g(0.0176mmol) を、二座配位ホスファイト化合物として上記式(L-26)の化合物 0.0753g(0.0703mmol) をともにシュレンクに入れ、アルゴン置換後、0.7mlo340 DABE及び 1.4mlo トルエンを加えて 110 で 10 分間加熱し、パラ

ジウム濃度8.37mmol/lの触媒液を調製した。続いて、反応を行なうために別途用意したシュレンクをアルゴン置換し、3mlの34DABE及び3mlの酢酸を加えた。そこに上記の触媒液をマイクロシリンジで12.5 μ l加え、120 $^{\circ}$ で加熱することで反応を行なった(比較例1:アンモニウム化合物非存在系反応)。反応速度の評価は、反応前後の溶液組成をガスクロマトグラフィーで分析することによって34DABEの残存率及び14DABEの生成率を算出し、その値を下記の計算式に当てはめて平衡反応における反応速度定数を計算し、比較することで行なった。

[0159]

見かけ上、34DABEから14DABEが生成していく平衡反応における反応速度定数を $k(34D\rightarrow14D)$ とすると、 $k(34D\rightarrow14D)$ は以下の計算式により算出される。ただし、 $[14D]_e$ は平衡時の14DABEの平衡濃度(120 ℃反応では63%)であり、 $[34D]_0$ は反応初期の34DABE濃度(本反応条件では100%)であり、 $[14D]_t$ は反応時間 t 時間後における14DABEの生成濃度であり、t は反応時間(単位:時間)である。

[0160]

 $k_{(34D\rightarrow 14D)} = ([1 4 D]_{e}/[3 4 D]_{0}*ln ([1 4 D]_{e}/([1 4 D]_{e}/[1 4 D]_{e})))/t$

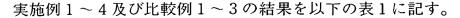
$[0\ 1\ 6\ 1]$

また、上記反応において、下記表1記載の種々のアミン類又はピリジン類をPdに対して200当量加え、求核剤の酢酸との酸塩基反応により表1記載の対応するアンモニウム化合物を調製し、反応系中に存在させたこと以外は、同様の条件で反応を行ない、同様に分析した(実施例1~4:アンモニウム化合物存在系)。

[0162]

また、上記反応において、Pdに対して200当量のアルカリ金属塩の存在下で、同様に反応を行ない、同様に分析した(比較例2及び3:アルカリ金属カチオン存在系)。

[0163]



【表1】

	添加した アミン類又は ピリジン類	アンモニウム 化合物	アルカリ金属塩	反応速度 定数 (h ⁻¹)	比活性
比較例1	_	-	_	0.30	1. 0 0
実施例1	4 - メトキシ ピリジン	$[H-Py-OMe]^+$ $[OAc]^-$	_	0.88	2. 93
実施例2	DBU	$[DBU-H]^+$ $[OAc]^-$	-	0.98	3. 27
実施例3	トリーn - ブチルアミン	$[H-NBu_3]^+$ $[OAc]^-$	_	0.90	3. 00
実施例4	TEEDA	[Et2HNCH2CH2NH Et2]2+ $2[OAc]-$	_	0.69	2.30
比較例 2	_	-	Na O Ac	0.52	1. 71
比較例3	_		Cs O Ac	0.67	2.20

注) DBU: 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0] ウンデセン-7

TEEDA: N, N, N', N'-Fhorthurfuuire

Py-OMe: 4-メトキシピリジン

 NBu_3 : hy-n-7 f hy-n-7

E t : エチル基

[0164]

上の結果より明らかなように、カウンターカチオンとしてアンモニウム化合物が存在した系は非存在系と比較して2.3~3.3倍に活性が向上していることが分かる。また、その活性向上率は、従来のアルカリ金属塩を用いた系よりも大きいことが分かる。

[0165]

<実施例5~7及び比較例4~6>

実施例 2 における触媒の配位子を上記式(L-26)の化合物からそれぞれ上記式(L-25)、(L-27)、(L-54)の化合物に変更して、同様に 200 当量の D B U を加え、反応系内でアンモニウム化合物を調製した系で反応を実施した(実施例 $5\sim7$)。また、比較例として、実施例 $5\sim7$ の条件において、アンモニウム化合物が存在しない系でも同様に反応を行なった(比較例 $4\sim6$

) 。

[0166]

実施例5~7及び比較例4~6の結果を以下の表2に記す。

【表2】

	配位子	アンモニウム 化合物	反応速度定数 (h ⁻¹)	比活性
比較例4	(L-25)	-	0.34	1. 00
実施例5	(L-25)	[DBU-H] + [OAc] -	0.95	2. 77
比較例 5	(L-27)	_	0.40	1. 0 0
実施例 6	(L-27)	[DBU-H] + [OAc] -	0.80	2. 00
比較例 6	(L-54)	_	0.45	1. 00
実施例7	(L-54)	[DBU-H] + [OAc] -	1. 15	2.55

[0167]

上の結果から明らかなように、他の二座配位ホスファイト配位子を用いた系においても、アンモニウム化合物の存在によって同様に活性が2.0~2.8倍に向上していることが分かる。

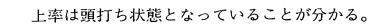
[0168]

<実施例8>

実施例 5 と同様に、パラジウムー二座配位ホスファイト(L-26)触媒系の下、DBU又はトリーn-ブチルアミンを加え、反応系内でそれぞれ対応するアンモニウム化合物を調製した系で 3 4 DABEの異性化反応を別々に行なった。それぞれ対応するアンモニウム化合物の存在量をパラジウムに対して 1 0 0、5 0、2 0、5 、0 当量と変化させて活性の比較を行なった。横軸にパラジウムに対するアンモニウム化合物の存在量を、縦軸に反応速度定数を取った時の相関を表わすグラフを図 1 に示す。

[0169]

図1から明らかなように、パラジウムに対して20当量のアンモニウム化合物 の存在によって、活性は約2倍にまで高められ、約50当量の存在でほぼ活性向



[0170]

<実施例9及び比較例7>

パラジウムー二座配位ホスファイト(L-26)触媒の存在下、アリル原料化 合物としてアリルメチル炭酸エステルを用い、求核剤としてフェノキシドを用い たアリル化反応を行なうことでアリルフェニルエーテルを製造する反応に本発明 を適用した。

[0171]

遷移金属化合物としてパラジウム含有量21.5重量%のトリスジベンジリデ ンアセトンジパラジウム 0. 0 1 4 9 g (0. 0 3 0 1 m m o 1) を、二座配位 ホスファイト化合物として上記式(L-26)の化合物0.1291g(0.1 205mmol) をシュレンクに入れ、アルゴン置換後、2.0mlのテトラヒ ドフランを加えて宰温で攪拌し、パラジウム濃度15.05mmol/lの触媒 液を調製した。続いて、反応を行なうために別途用意したシュレンクをアルゴン 置換し、3.85重量%のアリルメチル炭酸エステル及び6.06重量%のフェ ノールを含有するテトラヒドロフラン溶液4.45gを加えた。そこに上記の触 媒液をマイクロシリンジで5μl加え、60℃で加熱することで反応を行った(比較例7:カウンターカチオン非存在系反応)。反応速度の評価は、反応前後の 溶液組成をガスクロマトグラフィーで分析することによってアリルメチル炭酸エ ステルの転換率を求め、その値を下記の計算式に当てはめて反応速度定数を計算 した。ここでは、反応を、フェノールの濃度変化による影響を無視した擬一次的 な反応とみなし、反応速度:kを下記式より算出した。なお、式において、co nv.はアリルメチル炭酸エステルの転換率を表わし、tは、その時の反応時間 (単位:時間)である。

[0172]

k = -1 n (1 - c o n v.) / t

[0173]

また、上記の比較例7の条件に、更にパラジウムに対して200当量のDBU を加え、反応系内でアンモニウム化合物を調製した系で反応を行なった(実施例





9:アンモニウム化合物存在系)。

[0174]

実施例9及び比較例7の結果を以下の表3に記す。

【表3】

	アンモニウム化合物	反応速度定数 (h ⁻¹)	比活性
比較例7	_	0.59	1.00
実施例 9	[DBU-H]+ [OAe]-	1. 5 1	2.56

[0175]

上の結果から明らかなように、本発明を適用すると、他のアリル化反応の系に おいても同様に反応性を向上させることが可能であることが分かる。

[0176]

【発明の効果】

本発明によれば、周期表の第8~10族の遷移金属化合物及び特定構造の単座配位ホスファイト化合物又は任意の二座配位ホスファイト化合物からなる触媒を用いて、アリル原料化合物と求核剤とを反応させて新たなアリル化合物を製造する際に、求核剤のカウンターカチオンとしてアンモニウム化合物を反応系中に存在させることにより、極めて簡便に触媒活性を上昇させ、アリル化合物の製造効率を大幅に向上させることが可能となるので、工業的に極めて有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例8において、横軸にパラジウムに対するDBU又はトリーn-ブチルアミンから調製されたアンモニウム化合物の存在量を、縦軸に反応速度定数をそれぞれ取った場合の相関を表わすグラフである。

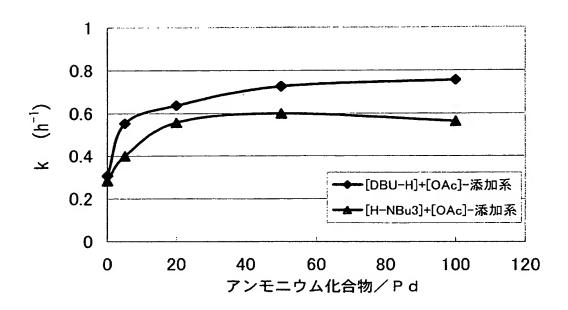


【書類名】

図面

図1]

アンモニウム化合物の存在量と 触媒活性との関係







要約書

【要約】

【課題】 遷移金属化合物及び二座配位ホスファイト化合物からなる触媒の下、 アリル原料化合物と求核剤とを反応させて新たなアリル化合物を製造する方法に おいて、触媒系に変更を加えることなく、簡便な手法によって触媒活性を上昇さ せ、アリル化合物の製造効率を向上させる。

【解決手段】 周期表の第8~10族に属する遷移金属からなる群より選ばれる 一以上の遷移金属を含む遷移金属化合物と、二座配位ホスファイト化合物とを含 む触媒の存在下、アリル原料化合物と求核剤とを反応させることによって新たな アリル化合物を製造する方法において、アンモニウム化合物を反応系に存在させ る。

【選択図】 なし

特願2002-261870

出願人履歴/情報

識別番号

[0000059/68]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1994年10月20日 名称変更 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱化学株式会社